

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2017年2月16日(16.02.2017)



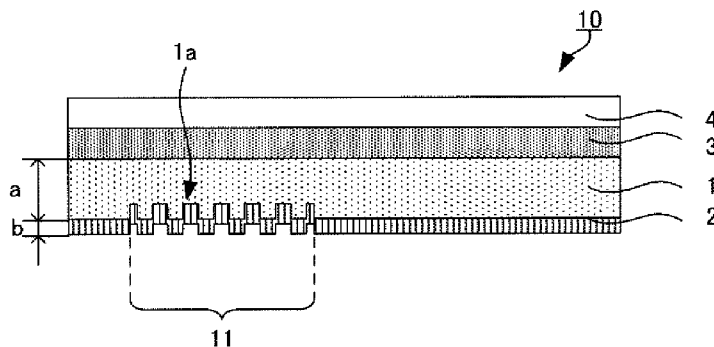
(10) 国際公開番号
WO 2017/026521 A1

- (51) 国際特許分類:
G03H 1/02 (2006.01) G02B 5/18 (2006.01)
B42D 25/328 (2014.01) G09F 3/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/073626
- (22) 国際出願日: 2016年8月10日(10.08.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-159957 2015年8月13日(13.08.2015) JP
特願 2015-159958 2015年8月13日(13.08.2015) JP
- (71) 出願人: 大日本印刷株式会社(DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 鈴木 慎一郎(SUZUKI, Shinichiro); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 山下 昭彦, 外(YAMASHITA, Akihiko et al.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目16番10号 オークビル京橋3階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

- (54) Title: HOLOGRAM STRUCTURE
- (54) 発明の名称: ホログラム構造体

[図2]



(57) Abstract: The main purpose of the present invention is to provide a hologram structure having excellent fraud prevention properties and design properties. The present invention solves the above problem by providing a hologram structure characterized in having: a hologram layer that has a reflective hologram formation region in which there is recorded a phase-type Fourier transform hologram for converting light entering from a point light source into a desired optical image; and a vapor deposition layer formed so as to be in contact with the surface of the reflective hologram formation region of the hologram layer, the reflective hologram formation region being 5 to 50 square millimeters large, as seen in plan view, and the surface of the reflective hologram formation region having protrusions and recesses.

(57) 要約: 本発明は、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体を提供することを主目的とする。本発明は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記反射型ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記反射型ホログラム形成領域の平面視サイズが、5mm角以上50mm角以下の範囲内であることを特徴とするホログラム構造体を提供することにより、上記課題を解決する。



WO 2017/026521 A1

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：ホログラム構造体

技術分野

[0001] 本発明は、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体に関するものである。

背景技術

[0002] ホログラムは、波長の等しい二つの光（物体光と参照光）を干渉させることによって、物体光の波面が干渉縞として感光材料に記録されたものであり、干渉縞記録時の参照光と同一波長の光が当てられると干渉縞によって回折現象が生じ、元の物体光と同一の波面が再生することが可能である。ホログラムは、外観が美しく、複製が比較的困難である等の利点を有することから偽造防止用途等に多く使用されている。

ホログラムの使用方法としては、ホログラムに対して参照光を透過または反射させることで、光像として再生する方法が知られている。

例えば、特許文献1では、レーザー反射型ホログラムで反射した回折光をスクリーンに投影することで再生された光像を用いて、真贋判定を行うことが記載されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特許第4872964号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] しかしながら、特許文献1に記載されるようなスクリーンに投影した光像のみでは高度な偽造防止効果および意匠の付与が困難であるといった問題がある。

[0005] 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体を提供することを主目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 上記目的を達成するために、本発明は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記反射型ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記反射型ホログラム形成領域の平面視サイズが、5 mm角以上であることを特徴とするホログラム構造体を提供する。

[0007] 本発明によれば、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域（以下、単にホログラム形成領域と称する場合がある。）を有するホログラム層を用いることで、上記ホログラム構造体は、点光源により平面視上ホログラム形成領域内に光像を再生できる。

また、上記ホログラム形成領域の平面視サイズが、5 mm角以上50 mm角以内の範囲内であることにより、光像をホログラム形成領域内に視認可能に再生できる。

このため、ホログラム形成領域内に再生された光像をホログラム構造体に形成された印刷層等の他の機能層と組み合わせることが可能となること等により、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

[0008] 本発明においては、上記反射型ホログラム形成領域は、点光源から入射した光を上記光像へ変換可能なホログラムセルが複数配列されたものであり、上記ホログラムセルの平面視サイズが、0.25 mm角以上5 mm角以下の範囲内であることが好ましい。上記ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内への光像の再生が容易となるからである。

[0009] 本発明においては、上記凹凸表面の格子ピッチが、1.0 μm ～80.0 μm の範囲内であることが好ましい。上記ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内への光像の再生が容易となるからである。

[0010] 本発明においては、上記ホログラム構造体が、上記光像と組み合わせて用

いられる画像を表示する画像表示層を有することが好ましい。上記画像表示層が表示する画像と、上記ホログラム形成領域内に再生される光像とを組み合わせることが可能となり、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

[0011] 本発明においては、上記画像表示層が着色材および樹脂材料を有する印刷層を含むことが好ましい。上記印刷層は、様々な色およびパターンの画像を容易に描画でき、偽造防止性および意匠性に優れた上記ホログラム構造体を容易に形成できるからである。

[0012] 本発明においては、上記画像表示層が、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された回折格子図柄を有する第2ホログラム層を含むことが好ましい。上記第2ホログラム層は、参照光を照射した場合にのみ画像を表示でき、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体を容易に形成できるからである。

[0013] 本発明においては、上記回折格子図柄が、平面的に図柄を再生可能な平面回折格子図柄であることが好ましい。平面回折格子図柄と光像とを組み合わせることが可能となることで、ホログラム構造体は偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。また、平面回折格子図柄は高輝度なものとすることが容易であり、視認性に優れた回折格子図柄を再生できるからである。

[0014] 本発明においては、上記回折格子図柄が、立体的に図柄を再生可能な立体回折格子図柄であることが好ましい。立体回折格子図柄と光像とを組み合わせることが可能となることで、ホログラム構造体は偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

[0015] また、上記目的を達成するために、本発明は、ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記ホログラム層の上記ホログラム形成領域には、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセルと、上記ホログラム

セルと同一平面上に形成され、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄を再生する回折格子セルと、が配置されていることを特徴とするホログラム構造体を提供する。

[0016] 本発明によれば、ホログラム形成領域に、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセルと、回折格子図柄を描画する回折格子セルとが配置されていることにより、上記ホログラム形成領域内に上記光像および上記回折格子図柄の両者を再生することができる。

したがって、上記光像および上記回折格子図柄を組み合わせることにより、ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

[0017] 本発明においては、上記回折格子図柄が、平面的に図柄を再生可能な平面回折格子図柄であることが好ましい。平面回折格子図柄と光像とを組み合わせることが可能となることで、ホログラム構造体は偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。また、平面回折格子図柄は高輝度なものとすることが容易であり、視認性に優れた回折格子図柄を再生できるからである。

[0018] 本発明においては、上記ホログラム形成領域内の上記ホログラムセルの合計面積に対する上記回折格子セルの合計面積の割合（回折格子セルの合計面積／ホログラムセルの合計面積）が、 $1/4 \sim 3/2$ の範囲内であることが好ましい。上記面積の割合が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、光像および平面回折格子図柄の両者の視認性に優れたものとなるからである。

[0019] 本発明においては、上記回折格子図柄が、立体的に図柄を再生可能な立体回折格子図柄であることが好ましい。立体回折格子図柄と光像とを組み合わせることが可能となることで、ホログラム構造体は偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

[0020] 本発明においては、上記ホログラム形成領域内の上記ホログラムセルの合計面積に対する上記回折格子セルの合計面積の割合（回折格子セルの合計面

積／ホログラムセルの合計面積)が、 $1/3 \sim 3$ の範囲内であることが好ましい。上記面積の割合が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、光像および立体回折格子図柄の両者の視認性に優れたものとなるからである。

[0021] 本発明においては、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された接着層を有し、ホログラムシールとして用いられることが好ましい。ホログラムシールとして用いられることで、ホログラム構造体は、被着体に容易に偽造防止性および意匠性を付与できるからである。

[0022] 本発明においては、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成されたヒートシール層と、上記ホログラム層の上記蒸着層とは反対側の表面に形成された剥離容易層と、上記剥離容易層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された剥離用基材と、を有し、ホログラム転写箔として用いられることが好ましい。ホログラム転写箔として用いられることで、ホログラム構造体は、被着体に容易に偽造防止性および意匠性を付与できるからである。

[0023] 本発明においては、情報記録媒体として用いられることが好ましい。ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものであるため、偽造防止性および意匠性に優れた情報記録媒体とすることができるからである。

発明の効果

[0024] 本発明は、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体を提供できるという効果を奏する。

図面の簡単な説明

[0025] [図1]本発明のホログラム構造体の一例を示す概略平面図である。

[図2]図1のA-A線断面図である。

[図3]ホログラム構造体を用いた光像の再生方法を説明する説明図である。

[図4]ホログラム構造体を用いた光像の再生方法を説明する説明図である。

[図5]ホログラム構造体を用いた光像の再生方法を説明する説明図である。

[図6]本発明におけるホログラム形成領域を説明する説明図である。

- [図7]本発明におけるホログラム形成領域を説明する説明図である。
- [図8]本発明におけるホログラム形成領域を説明する説明図である。
- [図9]本発明における画像表示層を説明する説明図である。
- [図10]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。
- [図11]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略平面図および概略断面図である。
- [図12]本発明における第2ホログラム層を説明する説明図である。
- [図13]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。
- [図14]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。
- [図15]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。
- [図16]本発明のホログラム構造体の一例を示す概略平面図である。
- [図17]図16のA-A線断面図である。
- [図18]ホログラム構造体の使用例を説明する説明図である。
- [図19]本発明における回折格子図柄を説明する説明図である。
- [図20]本発明における画像表示層を説明する説明図である。
- [図21]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。
- [図22]本発明のホログラム構造体の他の例を示す概略断面図である。

発明を実施するための形態

- [0026] 本発明は、ホログラム構造体に関するものである。
- 以下、本発明のホログラム構造体について詳細に説明する。
- [0027] 本発明のホログラム構造体は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記反射型ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記反射型ホログラム形成領域の平面視サイズが、5mm角以上である態様（第1実施態様）と、ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記ホログラム層の上記ホログラム形成領域には、点光源から入射し

た光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセルと、上記ホログラムセルと同一平面上に形成され、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄を描画する回折格子セルと、が配置されている態様（第2実施態様）と、の2つの実施態様に分けることができる。

以下、本発明のホログラム構造体について、各実施態様に分けて説明する。

[0028] A. 第1実施態様

まず、本発明のホログラム構造体の第1実施態様について説明する。

本態様のホログラム構造体は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記反射型ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記反射型ホログラム形成領域の平面視サイズが、5mm角以上であることを特徴とするものである。

[0029] このような本態様のホログラム構造体について図面を参照して説明する。

図1は、本態様のホログラム構造体の一例を示す概略平面図であり、図2は、図1のA-A線断面図である。図1および図2に示すように、本態様のホログラム構造体10は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域11を有するホログラム層1と、上記ホログラム層1の上記反射型ホログラム形成領域11の凹凸表面1aに接するように形成された蒸着層2と、を有し、上記反射型ホログラム形成領域11の平面視サイズが、5mm角以上であるものである。

なお、この例では、ホログラム層1の蒸着層2とは反対側の表面に層間接着層3および透明基材4がこの順で積層する例を示すものである。

また、図1は説明の容易のため、透明基材および層間接着層の記載を省略するものである。また、図1では、破線で囲まれた領域がホログラム形成領

域 11 である。

[0030] 本態様によれば、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するホログラム層を用いることで、上記ホログラム構造体は、点光源をホログラム層の凹凸表面とは反対側（以下、観察面側と称する場合がある。）に配置して、観察面側からホログラム層を平面視した際に、ホログラム形成領域内に光像を再生可能なものである。

このため、上記ホログラム構造体は、光像を投影するスクリーン等を別途準備することなく、真贋判定および意匠性の発現等を容易に行うことができる。

また、ホログラム構造体に形成された印刷層等の他の機能層と組み合わせることで、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

さらに、点光源からの光照射を受けているときのみ光像を再生できることから、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

[0031] また、図 3 に例示するように、上記ホログラム形成領域 11 の平面視サイズが小さく、ホログラム構造体 10 からの光源 21 の位置が遠い場合には（図 3（a））、観察者 20 は、光像 13 の全体像（図 3 では「E」の文字）のうち一部のみしか視認できない場合がある（図 3（b））。また、図 4 に例示するように、平面視サイズの小さいホログラム形成領域 11 内に光像 13 の全体像の全てを視認可能とするためには光源 21 をホログラム構造体 10 に近接させる必要があるが（図 4（a））、この場合には、再生された光像 13（図 4 では「E」の文字）のサイズが小さく、観察者 20 は、光像 13 により表示される情報の視認が困難となる（図 4（b））。

これに対して、図 5 に例示するように、上記ホログラム形成領域 11 の平面視サイズが、5 mm 角以上であることにより、光源 21 を上記ホログラム構造体 10 から離れた場合でも（図 5（a））、観察者 20 は、上記ホログ

ラム形成領域 11 内に光像 13 の全体像（図 5 では「E」の文字）の全てを視認できる（図 5（b））。また、観察者 20 は再生された光像 13 により表示される情報の視認が容易となる。

[0032] 本態様のホログラム構造体は、ホログラム層および蒸着層を有するものである。

以下、本態様のホログラム構造体における各構成について説明する。

[0033] 1. ホログラム層

本態様におけるホログラム層は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するものである。

上記ホログラム形成領域の平面視サイズは、5 mm 角以上である。

[0034] ここで、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されるとは、原画像のフーリエ変換を介して得られたフーリエ変換像の位相情報を多値化して深さとして記録されることをいうものである。したがって、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラム層のホログラム形成領域には、凹凸表面が形成される。

上記ホログラム層は、ホログラム形成領域の凹凸表面を構成する凹凸形状の高低差により、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、すなわちフーリエ変換レンズとして機能するものである。このような機能により、任意の点光源から入射する光が所定の複数の方向に回折され所定のイメージが光像として形成されるものである。なお、上述の機能のことを「フーリエ変換レンズ機能」と称する場合がある。

上記ホログラム形成領域は、反射型であり、点光源を観察面側に配置して、観察面側からホログラム層を平面視した際に、ホログラム形成領域内に光像を再生可能なものである。

[0035] 上記ホログラム形成領域は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換可能な領域をいうものであり、具体的には、上記光像へ変換可能なホログラムセルの全てを含むことができる最小面積の長方形で囲まれる領域である。

[0036] 本態様において、ホログラム形成領域の平面視サイズが5 mm角以上であるとは、上記ホログラム形成領域が、5 mm角の正方形の範囲を少なくとも含む平面視形状であることをいうものである。したがって、ホログラム形成領域が長方形形状である場合には、その短辺の長さが5 mm以上であることをいうものであり、ホログラム形成領域が正方形形状である場合には、その1辺の長さが5 mm以上であることをいうものである。

本態様においては、上記平面視サイズが、5 mm角以上50 mm角以下の範囲内であることが好ましく、なかでも、5 mm角以上30 mm角以下の範囲内であることが好ましく、特に5 mm角以上15 mm角以下の範囲内であることが好ましい。上記平面視サイズの下限が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内の光像の視認が容易なものとなるからである。その結果、偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

また、上記平面視サイズの上限が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、低コスト化を図ることや、光像等と組み合わせて用いられる画像を表示する画像表示層等の形成が容易なものとなるからである。

[0037] 本態様において、上記ホログラム形成領域は、図6(a)で示されるように、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された1つのホログラムセル11a(以下、単に、ホログラムセルと称する場合がある。)からなるホログラム形成領域11(以下、単に、単一ホログラム領域と称する場合がある。)であってもよいが、通常、図6(b)で示されるようにホログラムセル11aを複数配列させて拡大させたホログラム形成領域11(以下、大判ホログラム領域と称する場合がある。)である。

なお、図6中の「E」は、単一、または大判ホログラム領域においてそれぞれ発現される光像13である。

[0038] 上記ホログラム形成領域が大判ホログラム領域である場合、ホログラム形成領域を構成する個々のホログラムセルの平面視サイズとしては、精度良く

ホログラム形成領域を形成可能なものであればよい。

上記平面視サイズは、0.25mm角以上5mm角以下の範囲内であることが好ましい。上記平面視サイズが上述の範囲内であることにより、上記ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内への光像の再生が容易なものとなるからである。

なお、上記平面視サイズは、上記ホログラムセルを含むことができる最小の正方形の大きさをいうものである。したがって、ホログラムセルが1辺1mmの正方形である場合の平面視サイズは1mm角となる。また、ホログラムセルの平面視形状が直径1mmの円形状である場合の平面視サイズは1mm角となる。

[0039] 上記ホログラムセルの上記ホログラム形成領域に占める平面視上の面積の割合としては、所望の光像を再生可能なものであれば特に限定されるものではないが、25%以上であることが好ましく、なかでも、50%以上であることが望ましい。上記面積割合が上述の範囲であることより、ホログラム構造体は、光像を鮮明に再生可能なものとなるからである。

[0040] 上記ホログラムセルの平面視形状としては、所望の平面視形状のホログラム形成領域を形成可能なものであれば良く、任意の形状とすることができる。具体的には、上記平面視形状は、正形状、長形状等の矩形状、台形状、三角形状、五角形状、六角形状等の多角形状、円形状、楕円形状、星型形状、ハート型形状等とすることができるが、ホログラム形成領域の形成容易の観点から、通常、矩形状が用いられる。

[0041] 本態様において、ホログラム形成領域の凹凸表面の凹凸形状は、光像として表示させる原画の画像データをもとに形成される多値化されたフーリエ変換像を、縦横方向に所望の範囲まで複数個配列させたときの、フーリエ変換像のパターンに相当するものである。

このような凹凸表面のホログラム形成領域へ形成方法としては、点光源から入射した光を所望の光像へ変換可能な凹凸表面を形成可能な方法であればよく、一般的なフーリエ変換ホログラムの形成方法を用いることができる。

上記形成方法は、具体的には、フーリエ変換像に対応した凹凸パターンを有するマスター原版を形成し、PET等の基材上に形成した紫外線硬化樹脂等の樹脂材料の塗膜に当該原版の凹凸パターンを転写することでホログラム形成領域の凹凸表面を形成する方法を挙げることができる。

また、マスター原版の凹凸パターンの転写を1回のみ行うことにより、ホログラム形成領域として、1つのホログラムセルからなる単一ホログラム領域を形成することができる。そして、マスター原版の凹凸パターンの転写を複数回行うことにより、ホログラム形成領域として、複数のホログラムセルが配列された所望の大きさの大判ホログラム形成領域を有するホログラム層を形成することができる。

[0042] マスター原版の形成方法としては、表示させる原画の画像データをもとに、計算によりフーリエ変換像を形成する。次に、上記フーリエ変換像のデータを二値以上に多値化したものを電子線描画用データへ変換し、上記電子線描画用データを希望の範囲まで配列させる。例えば、電子線描画用データを縦、横方向に各10個ずつ配列させる。次いで、配列した電子線描画用データをもとに電子線描画装置でマスター原版を作成する方法を用いることができる。

電子線描画用データとして上記フーリエ変換後のデータを二値化したものを用いた場合には、上記凹凸表面の凹凸形状は、図7(a)に示すように2段の凹凸形状となり、四値化したものを用いた場合には、図7(b)に示すように4段の凹凸形状となる。

本態様においては、上記フーリエ変換像のデータの多値化が、四値以上に多値化するもの、すなわち、上記凹凸形状が4段以上の凹凸形状であることが好ましい。複雑な形状の光像を再生可能となるからである。

[0043] 上記凹凸表面の格子ピッチとしては、点光源から入射した光を所望の光像へ変換可能なものであればよい。

具体的には、上記格子ピッチは、 $1.0\mu\text{m}\sim 80.0\mu\text{m}$ の範囲内であることが好ましい。上記格子ピッチが上述の範囲内であることにより、上記

ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内への光像の再生の容易なものとなるからである。

なお、格子ピッチは、例えば、図7中のPで示される幅をいうものである。

[0044] ここで、図8に例示するように、ホログラム構造体10のホログラム形成領域に対して所定の距離L1の位置に光源が配置され、ホログラム形成領域から所定の距離L2の位置で観察者20がホログラム形成領域を観察する場合、観察者20がホログラム形成領域の全領域で光像の全体像を観察できるためには、格子ピッチについて以下の式(1)が成り立つものとすることができる。

なお、 λ は回折光の波長、Pは凹凸表面の格子ピッチ、 θ_1 は光源からホログラム形成領域の端部まで到達するための入射角、 θ_2 はホログラム形成領域の端部からの回折光が観察者に到達するための回折角、nは回折の次数である。

$$P = n \lambda / (\sin \theta_1 + \sin \theta_2) \quad (1)$$

[0045] 上記格子ピッチの具体的な計算例としては、ホログラム形成領域が1辺が15mmの正方形であり、L1が50mm、L2が300mmであり、波長550nmの光である場合、 $\sin \theta_2 = 0.025$ であり、 $\sin \theta_1 = 0.148$ と計算され、観察者がホログラム形成領域の全領域で光像の全体像を観察するために必要な格子ピッチPは、最短で3179nmと計算される。

また、ホログラム形成領域が1辺が15mmの正方形であり、L1が1990mm、L2が2000mmであり、波長550nmの光である場合、 $\sin \theta_2 = 0.00374$ であり、 $\sin \theta_1 = 0.00377$ と計算され、上記格子ピッチPは、最短で73236nmと計算される。

さらに、ホログラム形成領域が1辺が10mmの正方形であり、L1が60mm、L2が60mmであり、波長550nmの光である場合、 $\sin \theta_2 = 0.083$ であり、 $\sin \theta_1 = 0.083$ と計算され、上記格子ピ

ッチPは、最短で3313nmと計算される。

[0046] 上記凹凸形状の深さは、0.01 μ m程度とすることができる。

なお、深さは、例えば、図7中のDで示されるものである。

[0047] 上記ホログラム形成領域において、上述のフーリエ変換レンズ機能を発現できる点光源の波長としては特に限定されるものではなく、所望の波長を対象とすることができる。また、点光源の波長としては、一波長の単色光に限られず、多波長を含む光であってもよく、さらには白色光であってもよい。

[0048] 上記ホログラム層を構成する材料としては、ホログラム形成領域において上述したフーリエ変換レンズ機能を発現するための凹凸形状を形成でき、かつ、所定の屈折率を示すものであれば特に限定されない。上記ホログラム層を構成する材料が示す屈折率としては、特に限定されるものではなく、本態様のホログラム構造体の用途に応じて適宜設定が可能である。

また、上記屈折率の基準となる波長も特に限定されず、400nm~750nmの範囲内から適宜選択すればよい。中でも本態様においては、波長555nmにおける屈折率が1.3~2.0の範囲内であることが好ましく、特に1.33~1.8の範囲内であることが好ましい。ここで、上記屈折率は分光エリプソメーターにより測定することができる。

[0049] 上記ホログラム層の材料としては、従来からレリーフ型ホログラム等の形成に使用されている樹脂材料、例えば、熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、電離放射線硬化性樹脂等の硬化性樹脂の硬化物、熱可塑性樹脂等を用いることができる。

[0050] 上記熱硬化性樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、アクリル変性ウレタン樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。また、上記熱可塑性樹脂としては、例えば、アクリル酸エステル樹脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、ポリスチレン樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は単独重合体であっても2種以上の構成成分からなる共重合体であってもよい。また、これらの樹脂は単独で用いてもよく、2種以上を併用しても

よい。

- [0051] 上述の熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂は、各種イソシアネート化合物、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸亜鉛等の金属石鹼、ベンゾイルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド等の有機過酸化物、ベンゾフェノン、アセトフェノン、アントラキノン、ナフトキノ、アゾビスイソブチロニトリル、ジフェニルスルフィド等の熱あるいは紫外線硬化剤を含んでいてもよい。
- [0052] また、上記電離放射線硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ変性アクリレート樹脂、ウレタン変性アクリレート樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂等が挙げられ、中でもウレタン変性アクリレート樹脂が好ましく、特に特開2007-017643号公報で示される化学式で表わされるウレタン変性アクリル系樹脂が好ましい。
- [0053] 上記電離放射線硬化性樹脂を硬化させる際には、架橋構造、粘度の調整等を目的として、単官能または多官能のモノマー、オリゴマー等を併用することができる。上記単官能モノマーとしては、例えば、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ビニルピロリドン、（メタ）アクリロイルオキシエチルサクシネート、（メタ）アクリロイルオキシエチルフタレート等のモノ（メタ）アクリレート等が挙げられる。また、2官能以上のモノマーとしては、骨格構造で分類するとポリオール（メタ）アクリレート（例えば、エポキシ変性ポリオール（メタ）アクリレート、ラクトン変性ポリオール（メタ）アクリレート等）、ポリエステル（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、その他ポリブタジエン系、イソシアヌール酸系、ヒダントイン系、メラミン系、リン酸系、イミド系、ホスファゼン系等の骨格を有するポリ（メタ）アクリレート等が挙げられる。さらに、紫外線、電子線硬化性である種々のモノマー、オリゴマー、ポリマーが利用できる。
- [0054] 更に詳しくは、2官能のモノマー、オリゴマーとしては、例えば、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（

メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート等が挙げられる。3官能のモノマー、オリゴマー、ポリマーとしては、例えば、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、脂肪族トリ (メタ) アクリレート等が挙げられる。4官能のモノマー、オリゴマーとしては、例えば、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ (メタ) アクリレート、脂肪族テトラ (メタ) アクリレート等が挙げられる。また、5官能以上のモノマー、オリゴマーとしては、例えば、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート等が挙げられる。また、ポリエステル骨格、ウレタン骨格、ホスファゼン骨格を有する (メタ) アクリレート等が挙げられる。官能基数は特に限定されるものではないが、官能基数が3より小さいと耐熱性が低下する傾向があり、また、20を超える場合には柔軟性が低下する傾向があるため、特に官能基数が3~20の範囲内のものが好ましい。

[0055] 上記のような単官能または多官能のモノマー、オリゴマーの含有量としては適宜調整することができるが、通常、電離放射線硬化性樹脂100重量部に対して50重量部以下とすることが好ましく、中でも0.5重量部~20重量部の範囲内が好ましい。

[0056] また、上記ホログラム層は必要に応じて、光重合開始剤、重合禁止剤、劣化防止剤、可塑剤、滑剤、染料や顔料などの着色剤、界面活性剤、消泡剤、レベリング剤、チクソトロピー性付与剤等の添加剤を、適宜加えてもよい。

[0057] 上記ホログラム層の膜厚としては、上記ホログラム層が自己支持性を有する場合、0.05mm~5mmの範囲内が好ましく、中でも0.1mm~3mmの範囲内であることが好ましい。一方、上記ホログラム層が自己支持性を有さず、後述する透明基材上に形成される場合は、ホログラム層の膜厚としては、0.1 μ m~50 μ mの範囲内が好ましく、中でも2 μ m~20 μ mの範囲内とすることが好ましい。

なお、上記ホログラム層の膜厚は、具体的には、既に説明した図2のaで示される距離である。

また、ホログラム層の平面視上の大きさ等については、本態様のホログラム構造体の用途に応じて適宜設定することができる。

[0058] 本態様におけるホログラム層は、ホログラム形成領域を少なくとも有するものであるが、上記ホログラム形成領域の他に、凹凸形状が形成されていない領域（非ホログラム形成領域）を有してもよい。

上記ホログラム層において上記各領域が占める割合については、特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜選択することができる。

[0059] 2. 蒸着層

本態様における蒸着層は、ホログラム層のホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成されるものである。

[0060] 上記蒸着層は、透明性を有していても良く、反射性を有するものであっても良い。

上記蒸着層が透明性を有する透明蒸着層である場合には、ホログラム構造体は、平面視した際にホログラム形成領域が光沢を有しないものとなる。このため、上記ホログラム構造体は、上記ホログラム形成領域が隠ぺいされたものとなり、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

一方、上記蒸着層が反射性を有する反射性蒸着層である場合には、ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内に鮮明に光像を再生可能となる。このため、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

[0061] 上記透明蒸着層は、全光線透過率（以下、単に光透過率とする場合がある。）が80%以上であることが好ましく、中でも90%以上であることがより好ましい。上記光透過率であることにより、ホログラム構造体は、ホログラム形成領域がより隠ぺいされたものとなるからである。

なお、上記光透過率は、JIS K7361-1（プラスチック-透明材

料の全光透過率の試験方法)により測定した値である。

[0062] 上記蒸着層を構成する材料としては、ホログラム層との間で屈折率差を生じる材料であれば特に限定されるものではない。上記反射性蒸着層を形成可能な材料としては、例えば、Mg、Al、Ti、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Se、Rb、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、Au、Pb、もしくはBi等の金属を挙げることができる。

また、上記透明蒸着層を形成可能な材料としては、例えば、上記金属の酸化物を挙げることができる。

上記材料は、単独でまたは2以上の材料を組み合わせたものも用いることができる。

[0063] 上記蒸着層の厚みは、所望の反射性、色調、デザイン、用途等の観点から適宜に設定でき、例えば、 $50 \text{ \AA} \sim 1 \mu\text{m}$ の範囲内であることが好ましく、なかでも $100 \text{ \AA} \sim 1000 \text{ \AA}$ の範囲内であることが好ましい。

また、上記厚みは、蒸着層に透明性を持たせるとの観点からは、 200 \AA 以下であることが好ましく、蒸着層に隠ぺい性を持たせるとの観点からは、 200 \AA を超える厚みであることが好ましい。

なお、上記蒸着層の厚みは、具体的には、既に説明した図2のbで示される距離である。

[0064] 上記蒸着層の形成箇所は、少なくともホログラム形成領域内の全ての凹凸表面と平面視上重なるものであればよく、ホログラム層の凹凸表面側の全表面を覆うものであってもよい。

[0065] 上記蒸着層の形成方法としては、一般的な蒸着層の形成方法を用いることができ、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等を挙げることができる。

[0066] 3. その他の構成

本態様のホログラム構造体は、ホログラム層を有するものであるが、必要に応じてその他の構成を有するものであっても良い。

[0067] (1) 透明基材

本態様のホログラム構造体は、上記ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面に形成された透明基材を有するものであってもよい。透明基材を有することにより、本態様のホログラム構造体の熱的または機械的強度を高めることができるからである。

[0068] 上記透明基材は、上記ホログラム層と直接接するように形成されるものであっても良く、他の層を介して形成されるものであってもよい。

例えば、透明基材は、後述する層間接着層を介してホログラム層表面に接着されたものとすることができる。

[0069] 上記透明基材の光透過率は、80%以上であることが好ましく、中でも90%以上であることがより好ましい。透明基材の光透過率を上述の範囲内とすることにより、ホログラム構造体は、光像の視認が容易なものとなるからである。

[0070] また、上記透明基材はヘイズ値が低いものほど好ましく、具体的にはヘイズ値が0.01%~5%の範囲内であるものが好ましく、中でも0.01%~3%の範囲内であるものが好ましく、特に0.01%~1.5%の範囲内であるものが好ましい。透明基材のヘイズ値を上記範囲内とすることにより、視認性を阻害することなくホログラム形成領域において発現する光像の表示が可能となるからである。なお、上記透明基材のヘイズ値は、JIS K 7136に準拠して測定した値とする。

[0071] 上記透明基材の構成材料としては、上述の光透過率およびヘイズ値を示すものであれば特に限定されるものではなく、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、アクリル樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリルスチレン樹脂等の樹脂フィルム、石英ガラス、パイレックス（登録商標）、合成石英板等のガラスを用いることができる。中でも、上記透明基材としては、軽量且つ破損等の危険性が少ないという点から、樹脂フィルムを用いることが好ましく、複屈折性の面からポリカーボネートが最適である。

[0072] 上記透明基材は、必要に応じて、添加剤が含まれていてもよい。

上記添加剤としては、例えば、分散剤、充填剤、可塑剤、帯電防止剤等を挙げることができる。

[0073] 上記透明基材の膜厚としては、ホログラム層等を支持するための剛性および強度を有することが可能な厚さであればよく、例えば0.005mm～5mm程度であることが好ましく、中でも0.02mm～1mmの範囲内であることが好ましい。また、上記透明基材の形状については特に限定されるものではなく、本態様のホログラム構造体の使用形態に応じて適宜選択することができる。

[0074] 上記透明基材は、他の層との密着性を向上させるために、例えば表面にコロナ処理等が行われていてもよい。

[0075] (2) 画像表示層

本態様のホログラム構造体は、上記光像と組み合わせて用いられる画像を表示する画像表示層を有することが好ましい。

上記画像表示層が表示する画像と、上記ホログラム形成領域内に再生される光像とを組み合わせることが可能となり、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

[0076] ここで、上記画像としては、光像と組み合わせることで、偽造防止性および意匠性を向上できるものであれば特に限定されるものではない。

上記画像としては、具体的には、本態様のホログラム構造体の用途等に応じて、適宜設定することができ、例えば、パターン、線画、文字、図形、記号等のみならず、単に全面が着色された態様も含むものである。

また、上記光像と組み合わせることで偽造防止性および意匠性をより向上できる画像としては、例えば図9(a)および(b)に例示するように、上記ホログラム形成領域の形成箇所を指し示す矢印、上記形成箇所を囲む枠、上記形成箇所であることを示す文字等のホログラム形成領域の認識に用いられる画像、図9(c)および(d)に例示するように上記光像が図形の一部を表わすものである場合に、図形の他の部分を表わす画像、図9(e)および(f)に例示するように上記光像が文字列または数列の一部を表わす画像

である場合に、文字列または数列の他の部分を表わす画像、上記光像が太陽を表わす画像である場合に、太陽の周囲に配置される雲や空等の背景を表わす画像等の上記ホログラム形成領域内に再生される光像との組み合わせで1つの統一感のある画像を形成する画像等を挙げることができる。

なお、図9(a)、(c)および(e)は、それぞれ、光像再生前の状態を示し、図9(b)、(d)および(f)は、それぞれ光像再生時の状態を示すものである。

また、図9(a)および(b)では、画像15は、ホログラム形成領域11の形成箇所を指し示す矢印であり、ホログラム形成領域11内に光像13として「ホンモノ」を表わす文字列を再生可能なものである。図9(c)および(d)では、画像15は、楕円の一部であり、光像13により示される楕円の他の部分と組み合わせで1つの楕円を表示可能なものである。図9(e)および(f)では、画像15は、文字列「ホンモノ」の一部であり、光像13により示される文字列「ホンモノ」の他の部分と組み合わせで1つの意味のある文字列「ホンモノ」を表示可能なものである。

[0077] 上記画像表示層は、所望の画像を表示できるものであればよく、例えば、着色材および樹脂材料を有する印刷層、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された回折格子図柄を有する第2ホログラム層等を挙げることができる。

上記印刷層は、様々な色およびパターンの画像を容易に描画できる。上記第2ホログラム層は、参照光を照射した場合にのみ画像を表示できる。このため、上記印刷層等は、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体を容易に形成できるからである。

上記画像表示層は、1種類のみであっても良く、2種類以上を組み合わせで用いるものであっても良い。例えば、画像表示層は、複数の印刷層を含むもの、印刷層および第2ホログラム層を含むもの等とすることができる。

以下、印刷層および第2ホログラム層について説明する。

[0078] (a) 印刷層

上記印刷層は、着色材および樹脂材料を有するものである。

上記樹脂材料としては、例えばポリカーボネート類、ポリエステル類、セルロース誘導体、ノルボルネン系樹脂、ポリ塩化ビニル類、ポリ酢酸ビニル類、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリプロピレン系類、ポリエチレン系類、スチレン系類等の樹脂を用いることができる。

上記着色材としては、印刷層として一般的に用いられるものを使用でき、無機顔料および有機顔料等の顔料、酸性染料、直接染料、分散染料、油性染料、含金属油性染料、および昇華性色素等の染料等を挙げることができる。

また、上記着色材としては、紫外線または赤外線を吸収することにより蛍光を発する紫外線発光材料および赤外線発光材料等の蛍光発光材料、偏光コレステリック高分子液晶顔料、ガラスビーズなど反射鏡となる粒子も用いることができる。

上記印刷層の形成方法、すなわち、印刷方法としては、一般的な印刷層の形成方法と同様の方法を用いることができる。上記印刷方法としては、具体的には、インクジェット印刷、スクリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷等の各種印刷法を挙げることができる。

また、上記印刷層に用いられるインクとしては、一般的な印刷層の形成に用いられるものを使用でき、上記樹脂材料および着色材を溶媒中に分散または溶解したものをを用いることができる。

[0079] 上記印刷層の形成位置としては、ホログラム形成領域内での光像の再生および視認を妨げない位置であれば特に限定されるものではなく、ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面上、ホログラム層と同一平面上、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面上等とすることができる。

上記印刷層は、上記ホログラム形成領域と平面視上重なるものであっても良いが、通常、重ならないものである。

図10は、上記印刷層5が、透明基材4のホログラム層1とは反対側の表面上に形成される例を示すものである。

[0080] (b) 第2ホログラム層

上記第2ホログラム層は、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された回折格子図柄を有し、参照光を照射することにより、回折格子セルが配置されたパターン形状の図柄が再生されるものである。

ここで、回折格子図柄は、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された図柄であり、原図柄を例えば基盤目状の微細セルに分割し、分割された微細セルを回折格子に置き換えて描画されたものである。

図11(a)は、第2ホログラム層を有するホログラム構造体の一例を示す概略平面図であり、図11(b)は図11(a)のB-B線断面図である。図11は、蒸着層2のホログラム層1とは反対側の表面に層間接着層3を介して第2ホログラム層6および第2蒸着層7がこの順で積層しているホログラム構造体10を示すものである。また、図11では、回折格子セル16aが「F」の文字のパターン状に配置された回折格子図柄16を有する第2ホログラム層6が用いられる例を示すものであり、参照光を照射することで、回折格子図柄16に「F」の文字が再生されるものである。

なお、図11(a)は説明の容易のため、透明基材、層間接着層、ホログラム層および蒸着層の記載を省略するものである。

[0081] 上記回折格子図柄は、平面的に図柄を再生可能な平面回折格子図柄であってもよく、立体的に図柄を再生可能な立体回折格子図柄であってもよい。

上記回折格子図柄が平面回折格子図柄であることにより、平面回折格子図柄と上記光像とを組み合わせることが可能となることで、ホログラム構造体は偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。また、平面回折格子図柄は高輝度なものとすることが容易であり、視認性に優れた回折格子図柄を再生できるからである。

上記回折格子図柄が立体回折格子図柄であることにより、立体回折格子図柄と光像とを組み合わせることが可能となることで、ホログラム構造体は偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

上記回折格子図柄は、平面回折格子図柄または立体回折格子図柄であって

も良く、両者を組み合わせたものであっても良い。

[0082] 上記平面回折格子図柄の形成方法としては、回折格子図柄が回折光の振幅が同程度の回折格子セルを用いて描画する方法を挙げることができる。

また、回折光の振幅を同程度とする方法としては、特許第4984938号公報に記載されるように、回折格子セルの回折格子が形成されている領域（以下、単に回折格子形成領域と称する場合がある。）の面積を同程度とする方法が挙げられる。すなわち、平面回折格子図柄は、回折格子形成領域の面積が同程度の回折格子セルを敷き詰めることで描画されたものとしてすることができる。また、同程度の回折格子形成領域の面積として、どの程度の回折格子形成領域の面積の回折格子セルを用いるかについては、平面回折格子図柄が再生可能なものであればよく、再生される平面回折格子図柄のサイズ、カラー表示の有無等に応じて適宜設定されるものである。

[0083] 上記立体回折格子図柄の形成方法としては、上記回折格子図柄の端部側より中央部側に回折光の振幅が大きい回折格子セルを配置する方法が挙げられる。

より具体的には、図11では、「F」の文字が回折格子セルを幅方向に3個配置した描画線により描画されている（例えば、16a1、16a2および16a3）。この場合、描画線の幅方向の端部側に配置される回折格子セル16a1および16a3より、中央部側に配置される回折格子セル16a2を回折光の振幅が大きい回折格子セルとすることで、参照光を照射した際に「F」の文字が立体的に浮かび上がるように再生することが可能となる。

また、回折光の振幅を端部側より中央部側を大きくする方法としては、特許第4984938号公報に記載されるように、端部側より中央部側に回折格子形成領域の面積が広い回折格子セルを配置する方法を挙げることができる。すなわち、立体回折格子図柄は、回折格子図柄の端部側より中央部側に回折格子形成領域の面積が広い回折格子セルが配置されたものとしてすることができる。

例えば、図11中の回折格子セル16a1～16a3の拡大図である図1

2に例示するように、描画線の幅方向の端部側に配置される回折格子セル16a1および16a3より、中央部側に配置される回折格子セル16a2を、回折格子形成領域26の面積が広い回折格子セルとすることができる。

[0084] 回折格子図柄を描画するためにパターン状に配置される回折格子セル（以下、単に回折格子セルと称する場合がある。）の格子ピッチ、格子角度、格子密度（図柄に対して回折格子セルが占める平面視上の面積割合）は、参照光が照射された際に再生される図柄に応じて適宜設定されるものである。

例えば、格子ピッチをそれぞれ1.2 μm 程度、1.0 μm 程度および0.8 μm 程度とすることで、それぞれ波長600 nm用（赤色用）、500 nm用（緑色用）、400 nm（青色用）の光を回折するものとするこゝで、カラー画像を再生可能なものとするこゝでできる。

また、さらに格子角度および格子密度により様々な図柄を表現可能なものとするこゝでできる。

[0085] 上記回折格子セルの平面視サイズとしては、再生される回折格子図柄に応じて適宜設定できるものであるが、例えば、5 μm 角以上100 μm 角以内とするこゝでできる。上記平面視サイズであるこゝにより、高精細な回折格子図柄を描画できるからである。また、回折格子図柄を描画する個々の回折格子セルの存在を隠ぺいできるからである。

[0086] 上記回折格子セルの平面視形状としては、再生される回折格子図柄に応じて適宜設定できるものであるが、例えば、上記「1. ホログラム層」の項に記載のホログラムセルと同様とするこゝでできる。

[0087] 上記第2ホログラム層の形成箇所は、上記ホログラム層と同一平面上であっても良く、上記ホログラム層の上記蒸着層側の表面上または、上記蒸着層とは反対側の表面上であってもよい。第2ホログラム層がホログラム層と同一平面上に形成される例としては、ホログラム層および第2ホログラム層が一体として形成され、ホログラム層の非ホログラム領域に回折格子図柄が形成されるものを挙げるこゝでできる。

なお、既に説明した図11は、上記第2ホログラム層6が、ホログラム層

1の蒸着層2側の表面上に配置される例を示すものである。

また、上記第2ホログラム層は、通常、回折格子図柄がホログラム形成領域と平面視上重ならないように配置されるものである。

[0088] 上記第2ホログラム層に記録された回折格子図柄の再生に用いられる参照光については特に限定されるものではなく、一般的なホログラムに用いられるものを使用できる。

上記参照光としては、具体的には、可視光を含む光を用いることができる。

例えば、参照光は、上記ホログラム層のホログラム形成領域の再生に用いられる点光源と同一とすることができる。ホログラム形成領域に記録された光像の再生と同時に第2ホログラム層に記録された回折格子図柄を再生できるからである。

また、上記参照光は、点光源に限らず、太陽光等の平行光等であっても良い。

上記ホログラム構造体は、例えば、上記点光源以外の光源からの参照光が照射される明所に配置することで第2ホログラム層に記録された回折格子図柄を再生でき、さらにその明所において、上記点光源をホログラム形成領域上に配置することで光像も再生可能となる。

[0089] 上記第2ホログラム層を構成する材料としては、回折格子セルに含まれる回折格子として機能する凹凸形状を形成できるものであれば特に限定されるものではない。

このような材料としては、上記「1. ホログラム層」の項に記載のホログラム層の構成材料と同様とすることができる。

[0090] 上記第2ホログラム層の膜厚としては、安定的に回折格子の凹凸形状を形成可能なものであればよく、上記「1. ホログラム層」の項に記載のホログラム層と同様とすることができる。

[0091] 本態様のホログラム構造体は、第2ホログラム層の回折格子図柄の凹凸表面に接するように形成される第2蒸着層を有するものとすることができる。

このような第2蒸着層としては、第2ホログラム層を反射型として機能可能とすることができるものであれば特に限定されるものではなく、反射型ホログラムに一般的に用いられるものとするすることができる。具体的には、上記第2蒸着層は、上記「2. 蒸着層」の項に記載の内容と同様とすることができる。

[0092] (3) 層間接着層

本態様のホログラム構造体は、各構成間を接着する層間接着層を有するものであっても良い。

なお、層間接着層については、ホログラム構造体に一般的に用いられるものを使用することができ、上記透明基材およびホログラム層等を構成する材料に応じて適宜選択されるものである。

上記層間接着層としては、例えば、2液硬化型接着剤層、紫外線硬化型接着剤層、熱硬化型接着剤層、熱溶融型接着剤層等の公知の接着剤層を用いることができる。

上記層間接着層の厚みについては、接着する構成の大きさ等により適宜設定されるものである。

[0093] (4) 接着層

本態様のホログラム構造体は、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面に形成された接着層を有していてもよい。接着層を有することにより、上記ホログラム構造体は被着体に容易に貼付可能となるからである。

[0094] 上記接着層は透明性を有するものであっても良く、遮光性を有するものであっても良い。

[0095] 上記接着層は、粘着性を有する粘着剤層であってもよく、密着性および再剥離性の双方の特性を有する再剥離密着層であってもよい。

なお、上記接着層は、上記層間接着層と同様に2液硬化型接着剤層、紫外線硬化型接着剤層、熱硬化型接着剤層、熱溶融型接着剤層等の接着剤層であっても良い。

上記接着層が粘着剤層である場合、本態様のホログラム構造体を所望の部

材に強固に貼りあわせることができ、被着体からホログラム構造体が剥がれにくいものとするのが可能となる。

また、上記接着層が再剥離密着層である場合、再剥離密着層と被着体との間に空気が入らないよう密着させることにより、本態様のホログラム構造体を所望の部材に貼りあわせることができる。このような再剥離密着層は、被着体に粘着剤等による跡を残すことなく容易に密着および剥離を繰り返し行うことが可能であり、被着体へのダメージを抑えることができる。

[0096] 上記接着層が粘着剤層である場合、上記粘着剤層に用いられる樹脂としては、例えばアクリル系樹脂、エステル系樹脂、ウレタン系樹脂、エチレン酢酸ビニル系樹脂、ラテックス系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリウレタンエステル系樹脂、またはフッ化ビニリデン系樹脂（P V D F）、フッ化ビニル系樹脂（P V F）等のフッ素系樹脂、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド等のポリイミド系樹脂等を挙げることができる。上記樹脂は、中でもアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エチレン酢酸ビニル系樹脂、ラテックス系樹脂であることが好ましい。

[0097] また、上記接着層が再剥離密着層である場合、上記再剥離密着層に用いられる樹脂としては、例えばアクリル系樹脂、アクリル酸エステル樹脂、またはこれらの共重合体、スチレンーブタジエン共重合体、天然ゴム、カゼイン、ゼラチン、ロジンエステル、テルペン樹脂、フェノール系樹脂、スチレン系樹脂、クマロンインデン樹脂、ポリビニルエーテル、シリコーン樹脂等を挙げることができる。上記樹脂は、中でもアクリル系樹脂、シリコーン樹脂であることが好ましい。アクリル系樹脂は、被着体の表面に多少の凹凸がある場合であっても接着が可能であるからである。また、シリコーン樹脂は、密着および剥離を繰り返し行っても接着強度が低下しにくいからである。

[0098] 上記接着層の厚みとしては、本態様のホログラム構造体の種類や用途等に応じて適宜選択されるが、通常 $1\ \mu\text{m}$ ~ $500\ \mu\text{m}$ の範囲内とすることが好ましく、中でも $2\ \mu\text{m}$ ~ $50\ \mu\text{m}$ の範囲内とすることが好ましい。上記厚みが上述の範囲内であることにより、接着層は、接着性に優れたものとなるか

らである。

[0099] (5) 剥離シート

また、本態様のホログラム構造体は、上述した接着層上に剥離シートが配置されていてもよい。本態様のホログラム構造体を接着層を介して所望の被着体に貼り合わせる直前に、剥離シートと接着層とを剥離して使用することが可能となる。これにより、接着層と被着体との間に異物が付着することを防止できる。

[0100] 上記剥離シートとしては、接着層を保護することができ、且つ上記接着層から容易に剥離することが可能なものであれば、特に限定されるものではない。このような剥離シートとしては、例えばポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリフェニレンスルフィド（PPS）等からなる層とすることができる。

上記剥離シートの厚さは、本態様のホログラム構造体の種類や用途等に応じて適宜選択される。

[0101] また、上記剥離シートの接着層と接する側の面には、接着層との剥離操作を容易とするために、剥離処理が施されていることが好ましい。このような処理方法としては、例えばシリコン処理、アルキッド処理等が挙げられるが、特に限定されるものではない。

[0102] (6) 任意の部材

さらに、本態様のホログラム構造体は、上記透明基材上や上記ホログラム層の非ホログラム形成領域上に紫外線吸収層や赤外線吸収層、反射防止層等を有していてもよい。この様な層を有することにより、上記ホログラム構造体に紫外線吸収機能や赤外線吸収機能、反射防止機能等を付与することができ、本態様のホログラム構造体を各種フィルタ等としても用いることが可能となる。

なお、これらの層については、一般的に用いられるものと同様とすることができ、ここでの説明は省略する。

[0103] 4. ホログラム構造体

本態様のホログラム構造体は、ホログラム構造体を被着体に接着して使用するものであっても良く、被着体に接着せずに使用するものであっても良い。

[0104] 上記被着体に接着して使用する態様としては、被着体との接着に用いられる接着層を有するものであれば特に限定されるものではなく、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された接着層を有し、ホログラムシールとして用いられる態様（第1使用態様）、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成されたヒートシール層と、上記ホログラム層の上記蒸着層とは反対側の表面に形成された剥離容易層と、上記剥離容易層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された剥離用基材と、を有し、ホログラム転写箔として用いられる態様（第2使用態様）等を挙げることができる。

また、上記被着体に接着せずに使用する態様としては、情報記録媒体として用いられる態様（第3使用態様）等を挙げることができる。

[0105] (1) 第1使用態様

本態様のホログラム構造体の第1使用態様は、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された接着層を有し、ホログラムシールとして用いられる態様である。

[0106] このような本態様のホログラム構造体について図面を参照して説明する。図13は、本態様のホログラム構造体の一例を示す概略断面図である。図13に例示するように、本態様のホログラム構造体10は、上記蒸着層2の上記ホログラム層1とは反対側の表面に形成された接着層31を有し、ホログラムシールとして用いられるものである。

なお、図13中の符号については、図1および図2のものと同一の部材を示すものであるので、ここでの説明は省略する。

また、この例においては、ホログラム構造体10は、接着層31の蒸着層2とは反対側の表面に剥離シート32を有するものである。

[0107] 本態様によれば、上記接着層を有することにより、被着体に容易に偽造防

止性および意匠性を付与できる。

このような本態様のホログラム構造体の具体的な用途としては、チケット、ブランド品、製品の品質管理番号ラベル等に貼り付けて、点光源をホログラム形成領域上に配置することでホログラム形成領域内に再生される光像を用いて真贋判定を行う用途、意匠性を付与する用途等を挙げることができる。

[0108] 本態様のホログラム構造体は、接着層を有するものである。

なお、接着層については、上記「3. その他の構成」の項に記載の内容と同様とすることができる。

また、必要に応じて、上記「3. その他の構成」の項に記載のその他の構成等を有するものであっても良い。

[0109] (2) 第2使用態様

本態様のホログラム構造体の第2使用態様は、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成されたヒートシール層と、上記ホログラム層の上記蒸着層とは反対側の表面に形成された剥離容易層と、上記剥離容易層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された剥離用基材と、を有し、ホログラム転写箔として用いられる態様である。

[0110] このような本態様のホログラム構造体について図面を参照して説明する。

図14は、本態様のホログラム構造体の一例を示す概略断面図である。図14に例示するように、本態様のホログラム構造体10は、上記蒸着層2の上記ホログラム層1とは反対側の表面に形成されたヒートシール層33と、上記ホログラム層1の上記蒸着層2とは反対側の表面に形成された剥離容易層34と、上記剥離容易層34の上記ホログラム層1とは反対側の表面に形成された剥離用基材35と、を有し、ホログラム転写箔として用いられるものである。

なお、図14中の符号については、図1および図2のものと同じの部材を示すものであるので、ここでの説明は省略する。

また、この例においては、ホログラム構造体10は、ヒートシール層33

の蒸着層 2 とは反対側の表面に剥離シート 3 2 を有するものである。

[0111] 本態様によれば、上記ホログラム層および蒸着層を有するものであることにより、被着体に容易に偽造防止性および意匠性を付与できる。

また、ホログラム層の蒸着層とは反対側に剥離層を介して剥離用基材が形成されていることにより、被着体に貼付する前にホログラム構造体が損傷することを防ぐことができる。

また、本態様によれば、上記ヒートシール層を有するものであることにより、被着体に容易に偽造防止性および意匠性を付与できる。

このような本態様のホログラム構造体の具体的な用途としては、チケット、ブランド品、製品の品質管理番号ラベル等に所望のパターン形状で転写して、点光源をホログラム形成領域上に配置することでホログラム形成領域内に再生される光像を用いて真贋判定を行う用途、意匠性を付与する用途等を挙げることができる。

[0112] 本態様のホログラム構造体は、ヒートシール層、剥離容易層および剥離用基材を有するものである。

以下、本態様のホログラム構造体の各構成について詳細に説明する。

[0113] 上記ヒートシール層は、ホログラム層および蒸着層と被着体とを接着させる機能を有するものである。

[0114] このようなヒートシール層としては、ホログラム層と被着体とを接着できるものであれば特に限定されるものではなく、本態様のホログラム構造体からホログラム層および蒸着層が転写される被着体の種類に応じて適宜設定されるものである。

上記ヒートシール層としては、例えば、特開 2014-16422 号公報等に記載の熱可塑性樹脂を含むヒートシール層を用いることができる。

[0115] 上記剥離用基材は、ホログラム層および蒸着層等を支持するものである。

また、上記剥離用基材は、本態様のホログラム構造体を被着体に接着した後、ホログラム構造体から剥離されるものである。

このような剥離用基材としては、透明性を有するものであっても良く、遮

光性を有するものであっても良い。

上記剥離用基材を構成する材料および膜厚としては、例えば、上記「3. その他の構成」の項に記載の透明基材と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0116] 上記剥離容易層は、ホログラム層を接着層を介して被着体に接着した後に、剥離用基材およびホログラム層を容易に分離するために設けられるものである。

このような剥離容易層としては、上記「3. その他の構成」の項に記載の再剥離密着層を用いることができる。

[0117] 上記剥離容易層の平面視上の形成箇所としては、剥離用基材をホログラム層に対して容易に剥離可能とするものであれば特に限定されるものではない。

[0118] 本態様のホログラム構造体は、必要に応じて、上記「3. その他の構成」の項に記載のその他の構成等を有するものであっても良い。

[0119] (3) 第3使用態様

本態様のホログラム構造体の第3使用態様は、情報記録媒体として用いられる態様である。

[0120] このような本態様のホログラム構造体について図面を参照して説明する。図15は、本態様のホログラム構造体の一例を示す概略断面図である。図15に例示するように、本態様のホログラム構造体10は、蒸着層2のホログラム層1とは反対側の表面に形成された裏面側保護層36と、ホログラム層1の蒸着層2とは反対側の表面に形成された表面側保護層37と、を有し、情報記録媒体として用いられるものである。

なお、図15中の符号については、図1および図2のものと同一の部材を示すものであるので、ここでの説明は省略する。

[0121] 本態様によれば、情報記録媒体として用いれることで、偽造防止性および意匠性に優れた情報記録媒体とすることができる。

本態様のホログラム構造体の具体的な用途としては、例えば、クレジット

カード、キャッシュカード、ポイントカード等のカード、社員証、運転免許所等の身分証明書、通帳、パスポート等を挙げることができる。

[0122] 本態様のホログラム構造体は、ホログラム層および蒸着層を有するものであるが、情報記録媒体用の種類に応じてその他の構成を有するものであっても良い。

[0123] このようなその他の構成としては、例えば、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面に形成された裏面側保護層と、ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面に形成された表面側保護層と、を挙げることができる。

上記表面側保護層は、ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面に形成され、ホログラム層を保護するものであり、少なくとも、上記ホログラム形成領域と平面視上重なる領域が透明性を有するものが用いられる。

上記裏面側保護層は、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面に形成され、ホログラム層および蒸着層を保護するものである。このような裏面側保護層としては、透明性を有するものであっても良く、遮光性を有するものであっても良い。

このような表面側保護層および裏面側保護層の構成材料および膜厚については、例えば、上記「3. その他の構成」の項に記載の透明基材と同様とすることができる。

また、上記表面側保護層および上記裏面側保護層の形成箇所としては、ホログラム層等を保護できるものであればよいが、ホログラム層および蒸着層の全面を覆うものとすることができる。

[0124] 上記その他の構成としては、情報を記録する情報記録層等を挙げることができる。

上記情報記録層としては、印刷により情報が記録された印刷層、磁気等により情報が記録された磁気層、集積回路（IC）チップを含むICチップ層等を挙げることができる。

上記その他の構成としては、アンテナを含むアンテナ層等の機能層を含むことができる。

これらの情報記録層および機能層等の形成箇所としては、ホログラム形成領域内での光像の再生および視認を妨げない位置であれば特に限定されるものではなく、例えば、ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面上、ホログラム層と同一平面上、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面上等とすることができる。

[0125] 5. 製造方法

本態様のホログラム構造体の製造方法は、上記各構成を含むホログラム構造体を精度良く製造できる方法であれば特に限定されるものではなく、一般的なホログラム構造体の形成方法と同様の方法を用いることができる。

上記製造方法としては、具体的には、透明基材を準備し、ホログラム層および蒸着層をこの順で形成する方法を挙げることができる。

[0126] 6. 用途

本態様のホログラム構造体の用途としては、偽造防止用途に用いられるものとすることができ、クレジットカード、キャッシュカード等のカード等を含む情報記録媒体を挙げることができる。

また、ホログラム構造体を他の被着体に接着可能な接着層を有するものとし、被着体に貼付可能なホログラム構造体シール等として用いられるものであっても良い。

さらに、ホログラム構造体として、ヒートシール層を有するものとし、被着体に転写可能なホログラム構造体転写箔等として用いられるものであっても良い。

[0127] B. 第2実施態様

次に、本発明のホログラム構造体の第2実施態様について説明する。

本態様のホログラム構造体は、ホログラム形成領域を有するホログラム層と、上記ホログラム層の上記ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、を有し、上記ホログラム層の上記ホログラム形成領域には、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセルと、上記ホログラムセルと同一平面

上に形成され、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄を描画する回折格子セルと、が配置されていることを特徴とするものである。

[0128] このような本態様のホログラム構造体について図面を参照して説明する。

図16は、本態様のホログラム構造体の一例を示す概略平面図であり、図17は、図16のA-A線断面図である。図16および図17に示すように、本態様のホログラム構造体10は、ホログラム形成領域11を有するホログラム層1と、上記ホログラム層1の上記ホログラム形成領域11の凹凸表面に接するように形成された蒸着層2と、を有し、上記ホログラム層1の上記ホログラム形成領域11には、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセル13aと、上記ホログラムセル13aと同一平面上に形成され、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄12を描画する回折格子セル12aと、が配置されているものである。

なお、この例では、ホログラム層1の蒸着層2とは反対側の表面に層間接着層3および透明基材4がこの順で積層する例を示すものである。

また、図16は説明の容易のため、透明基材および層間接着層の記載を省略するものである。図16では、破線で囲まれた領域がホログラム形成領域11である。回折格子セル12aは文字「F」のパターン状に配置され、参照光が照射された際に文字「F」を表わす回折格子図柄12を描画するものである。ホログラムセル13aは、ホログラム形成領域11の回折格子セル12aが配置されていない箇所を埋めるように配置されるものである。

[0129] 本態様によれば、ホログラム形成領域に、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセルと、回折格子図柄を描画する回折格子セルとが配置されていることにより、上記ホログラム形成領域内に上記光像および上記回折格子図柄の両者を再生することができる。

したがって、上記光像および上記回折格子図柄を組み合わせることにより、ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

また、上記ホログラム構造体は、光像を投影するスクリーン等を別途準備することなく、真贋判定および意匠性の発現等を容易に行うことができる。

さらに、点光源からの光照射を受けているときのみ光像を再生できることから、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなる。

[0130] ホログラム構造体が既に説明した図16および図17に示すものである場合の使用例としては、図18(a)に示すように、例えば太陽光等の参照光を受けかつ点光源が配置されていない光像再生前では、ホログラム形成領域内に回折格子図柄として描画された「F」の文字のみが観察され、図18(b)に示すように、点光源がホログラム形成領域上に配置された光像再生後では、回折格子図柄および光像により「E」の文字が観察されるようにホログラム構造体を使用する例を挙げることができる。

これにより、ホログラム形成領域に回折格子図柄を描画する回折格子セル以外に光像を再生可能なホログラムセルが配置されていることを知らない観察者は、「F」の文字のみを観察し、上記ホログラムセルが配置されていることを知っている観察者のみが、「E」の文字を観察可能とすることができる。

このように、本態様のホログラム構造体は、上記ホログラム構造体の構成を知っている観察者のみが光像および回折格子図柄を組み合わせた画像を認識可能とすることにより偽造防止効果等を発現可能となる。

[0131] 本態様のホログラム構造体は、ホログラム層および蒸着層を有するものである。

以下、本態様のホログラム構造体における各構成について説明する。

[0132] 1. ホログラム層

本態様におけるホログラム層は、ホログラム形成領域を有するものである。

また、ホログラム層のホログラム形成領域には、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログ

ラムセルと、上記ホログラムセルと同一平面上に形成され、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄を描画する回折格子セルとが配置されるものである。

[0133] (1) ホログラム形成領域

上記ホログラム形成領域は、反射型であり、点光源を観察面側に配置して、観察面側からホログラム層を平面視した際に、ホログラム形成領域内に光像を再生可能なものである。

また、上記ホログラム形成領域は、レリーフ型であり、凹凸表面を有するものである。

[0134] 上記ホログラム形成領域は、ホログラムセルおよび回折格子セルが配置される領域をいうものであり、具体的には、上記ホログラムセルおよび回折格子セルの全てを含むことができる最小面積の長方形で囲まれる領域である。

[0135] 上記ホログラム形成領域の平面視サイズとしては、ホログラム形成領域内に上記光像の全体像の全てが視認可能なサイズであり、かつ、ホログラム形成領域内に再生された光像および回折格子図柄を観察者が容易に視認可能なサイズであることが好ましい。

既に説明した図3に例示するように、上記ホログラム形成領域11の平面視サイズが小さく、ホログラム構造体10からの光源21の位置が遠い場合には(図3(a))、観察者20は、光像13の全体像(図3では「E」の文字)のうち一部のみしか視認できない場合がある(図3(b))。また、既に説明した図4に例示するように、平面視サイズの小さいホログラム形成領域11内に光像13の全体像の全てを視認可能とするためには光源21をホログラム構造体10に近接させる必要があるが(図4(a))、この場合には、再生された光像13(図4では「E」の文字)のサイズが小さく、観察者20は、光像13により表示される情報の視認が困難となる(図4(b))。

これに対して、既に説明した図5に例示するように、上記ホログラム形成領域11の平面視サイズが所定の大きさ以上である場合には、光源21を上

記ホログラム構造体10から離れた場合でも(図5(a))、観察者20は、上記ホログラム形成領域11内に光像13の全体像(図5では「E」の文字)の全てを視認できる(図5(b))。また、観察者20は再生された光像13により表示される情報の視認が容易となる。

本態様においては、上記平面視サイズが、5mm角以上50mm角以下の範囲内であることが好ましく、なかでも、5mm角以上30mm角以下の範囲内であることが好ましく、特に5mm角以上15mm角以下の範囲内であることが好ましい。上記平面視サイズの下限が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、ホログラム形成領域内の光像の視認が容易なものとなるからである。その結果、偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

また、上記平面視サイズの上限が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、低コスト化を図ることや、光像等と組み合わせて用いられる画像を表示する画像表示層等の形成が容易なものとなるからである。

[0136] なお、ホログラム形成領域についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「1. ホログラム層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0137] (2) ホログラムセル

本態様におけるホログラムセルは、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたものである。

ここで、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されるとは、原画像のフーリエ変換を介して得られたフーリエ変換像の位相情報を多値化して深さとして記録されることをいうものである。したがって、位相型フーリエ変換ホログラムが記録されたホログラムセルは、凹凸表面を有する。

上記ホログラムセルは、ホログラムセルの凹凸表面を構成する凹凸形状の高低差により、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、すなわちフーリエ変換レンズとして機能するものである。

[0138] 上記ホログラムセルの上記ホログラム形成領域に占める平面視上の面積の

割合としては、所望の光像を再生可能なものであれば特に限定されるものではないが、25%~80%の範囲内であることが好ましく、なかでも、30%~70%の範囲内であることが好ましい。上記面積割合が上述の範囲であることより、ホログラム構造体は、光像を鮮明に再生可能なものとなるからである。

[0139] 本態様におけるホログラムセルの凹凸表面の凹凸形状は、光像として表示させる原画の画像データをもとに形成される多値化されたフーリエ変換像を、縦横方向に所望の範囲まで複数個配列させたときの、フーリエ変換像のパターンに相当するものである。

このようなホログラムセルの凹凸表面のホログラム形成領域への形成方法としては、点光源から入射した光を所望の光像へ変換可能な凹凸表面を形成可能な方法であればよく、一般的なフーリエ変換ホログラムの形成方法を用いることができる。

上記形成方法は、具体的には、フーリエ変換像に対応した凹凸パターンを有するマスター原版を形成し、PET等の基材上に形成した紫外線硬化樹脂等の樹脂材料の塗膜に当該原版の凹凸パターンを転写することでホログラムセルの凹凸表面を形成する方法を挙げることができる。

また、マスター原版の凹凸パターンの転写を複数回行うことにより、複数のホログラムセルが配置されたホログラム形成領域を有するホログラム層を形成することができる。

[0140] なお、ホログラムセルについてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「1. ホログラム層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0141] (3) 回折格子セル

上記回折格子セルは、上記ホログラムセルと同一平面上に形成されるものである。

上記回折格子セルは、上記ホログラム形成領域に、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄を描画するものである。

[0142] ここで、同一平面上に形成されるとは、上記ホログラムセルおよび上記回折格子セルが上記ホログラム層の同一表面に形成されることをいうものである。すなわち、上記ホログラム層の同一表面にホログラムセルの凹凸表面および回折格子セルの凹凸表面の両者が形成されることをいうものである。

[0143] 上記回折格子図柄は、参照光として可視光を照射することにより、回折格子セルが配置されたパターン形状の図柄が再生されるものである。

ここで、回折格子図柄は、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された図柄であり、原図柄を例えば碁盤目状の微細セルに分割し、分割された微細セルを回折格子セルに置き換えて描画されたものである。

既に説明した図16は、回折格子セル12aが「F」の文字のパターン状に配置されることにより回折格子図柄12を描画する例を示すものであり、上記回折格子図柄12に対して参照光を照射することで、上記ホログラム形成領域11内に回折格子図柄12として「F」の文字が再生される。

[0144] 上記図柄としては、光像と組み合わせることで、偽造防止性および意匠性を向上できるものであることが好ましい。

上記図柄としては、具体的には、本態様のホログラム構造体の用途等に応じて、適宜設定することができ、例えば、パターン、線画、文字、図形、記号等を挙げることができる。

また、上記光像と組み合わせることで、光像単独の場合と比較して、偽造防止性および意匠性を特に向上できる図柄としては、具体的には、図19(a)および(b)に例示するように、光像の再生箇所を指し示す矢印、光像の再生箇所を囲む枠、光像の再生箇所であることを示す文字等の光像の認識に用いられる図柄、図19(c)および(d)に例示するように上記光像が図形の一部を表わすものである場合に、図形の他の部分を表わす図柄、既に説明した図18ならびに図19(e)および(f)に例示するように上記光像が文字列または数列の一部を表わす画像である場合に、文字列または数列の他の部分を表わす図柄、上記光像が太陽を表わす画像である場合に、太陽の周囲に配置される雲や空等の背景を表わす図柄等の上記ホログラム形成領

域内に再生される光像との組み合わせで1つの統一感のある画像を形成する図柄等を挙げることができる。

なお、図19(a)、(c)および(e)は、それぞれ、光像再生前の状態を示し、図19(b)、(d)および(f)は、それぞれ光像再生時の状態を示すものである。

また、図19(a)および(b)では、回折格子図柄12は、ホログラム形成領域11内の光像13の再生箇所を指し示す矢印である。図19(c)および(d)では、回折格子図柄12は、楕円の一部であり、光像13により示される楕円の他の部分と組み合わせで1つの楕円を表示可能なものである。図19(e)および(f)では、回折格子図柄12は、文字列「ホンモノ」の一部であり、光像13により示される文字列「ホンモノ」の他の部分と組み合わせで1つの意味のある文字列「ホンモノ」を表示可能なものである。

[0145] 上記回折格子図柄は、平面的に図柄を再生可能な平面回折格子図柄であってもよく、立体的に図柄を再生可能な立体回折格子図柄であってもよい。

[0146] 図16では、「F」の文字が回折格子セルを幅方向に3個配置した描画線により描画されている（例えば、12a1、12a2および12a3）。この場合、描画線の幅方向の端部側に配置される回折格子セル12a1および12a3より、中央部側に配置される回折格子セル12a2を回折光の振幅が大きい回折格子セルとすることで、参照光を照射した際に「F」の文字が立体的に浮かび上がるように再生することが可能となる。

[0147] 上記回折格子セルの上記ホログラム形成領域に占める平面視上の面積の割合としては、所望の回折格子図柄を描画可能なものであれば特に限定されるものではない。

上記ホログラム形成領域内の上記ホログラムセルの合計面積に対する上記回折格子セルの合計面積の割合（回折格子セルの合計面積／ホログラムセルの合計面積）は、光像および回折格子図柄の両者を鮮明に再生できるものであれば特に限定されるものではないが、上記回折格子図柄が平面回折格子図

柄である場合には、 $1/4 \sim 3/2$ の範囲内であることが好ましく、なかでも、 $1/2 \sim 1$ の範囲内であることが好ましく、特に、 $5/8 \sim 7/8$ の範囲内であることが好ましい。上記面積の割合が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、光像および平面回折格子図柄の両者の視認性に優れたものとなるからである。

また、上記合計面積割合は、上記回折格子図柄が立体回折格子図柄である場合には、 $1/3 \sim 3$ の範囲内であることが好ましく、なかでも、 $2/3 \sim 2$ の範囲内であることが好ましく、特に、 $1 \sim 5/3$ の範囲内であることが好ましい。上記面積の割合が上述の範囲内であることにより、ホログラム構造体は、光像および立体回折格子図柄の両者の視認性に優れたものとなるからである。

[0148] 上記回折格子セルの凹凸表面のホログラム形成領域への形成方法については、一般的な回折格子図柄の形成方法と同様とすることができる。

[0149] 上記回折格子図柄の再生に用いられる参照光については特に限定されるものではなく、一般的なホログラムに用いられるものを使用できる。

上記参照光としては、具体的には、可視光を含む光を用いることができる。

例えば、参照光は、上記ホログラム層のホログラムセルに記録された光像の再生に用いられる点光源と同一とすることができる。ホログラム形成領域に記録された光像の再生と同時に回折格子図柄を再生できるからである。

[0150] なお、回折格子図柄および回折格子セルについてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「3. その他の構成」の「(2) 画像表示層」の「(b) 第2ホログラム層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0151] (4) その他

上記ホログラム層を構成する材料としては、ホログラム形成領域において上述したフーリエ変換レンズ機能を発現するホログラムセルの凹凸表面および回折格子図柄を形成する回折格子セルの凹凸表面を形成でき、かつ、所定

の屈折率を示すものであれば特に限定されない。

[0152] なお、ホログラム層の材料等のホログラム層についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「1. ホログラム層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0153] 2. 蒸着層

本態様における蒸着層は、ホログラム層のホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成されるものである。

[0154] 上記蒸着層の形成箇所は、少なくともホログラム形成領域内の全ての凹凸表面（ホログラムセルおよび回折格子セルの両者の凹凸表面）と平面視上重なるものであればよく、ホログラム層の凹凸表面側の全表面を覆うものであってもよい。

[0155] なお、蒸着層についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「2. 蒸着層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0156] 3. その他の構成

本態様のホログラム構造体は、ホログラム層を有するものであるが、必要に応じてその他の構成を有するものであっても良い。

[0157] (1) 透明基材

本態様のホログラム構造体は、上記ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面に形成された透明基材を有するものであってもよい。透明基材を有することにより、本態様のホログラム構造体の熱的または機械的強度を高めることができるからである。

なお、透明基材についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「3. その他の構成」の「(1) 透明基材」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0158] (2) 画像表示層

本態様のホログラム構造体は、上記光像と組み合わせて用いられる画像を表示する画像表示層を有することが好ましい。

上記画像表示層が表示する画像と、上記ホログラム形成領域内に再生される光像とを組み合わせることが可能となり、上記ホログラム構造体は、偽造防止性および意匠性に優れたものとなるからである。

[0159] ここで、上記画像としては、光像と組み合わせることで、偽造防止性および意匠性を向上できるものであれば特に限定されるものではない。上記画像は、上記ホログラム形成領域内に形成される回折格子図柄とも組み合わせて用いられるものであっても良い。

上記画像としては、具体的には、本態様のホログラム構造体の用途等に応じて、適宜設定することができ、例えば、パターン、線画、文字、図形、記号等のみならず、単に全面が着色された態様も含むものである。

また、上記光像と組み合わせることで偽造防止性および意匠性をより向上できる画像としては、例えば図20(a)および(b)に例示するように、上記ホログラム形成領域の形成箇所を指し示す矢印、上記形成箇所を囲む枠、上記形成箇所であることを示す文字等のホログラム形成領域の認識に用いられる画像、図20(c)および(d)に例示するように、上記光像および回折格子図柄が図形の一部を表わすものである場合に、図形の他の部分を表わす画像、図20(e)および(f)に例示するように上記光像が文字列または数列の一部を表わす画像である場合に、文字列または数列の他の部分を表わす画像、上記光像が太陽を表わす画像である場合に、太陽の周囲に配置される雲や空等の背景を表わす画像等の上記ホログラム形成領域内に再生される光像との組み合わせで1つの統一感のある画像を形成する画像等を挙げることができる。

なお、図20(a)、(c)および(e)は、それぞれ、光像再生前の状態を示し、図20(b)、(d)および(f)は、それぞれ光像再生時の状態を示すものである。

また、図20(a)および(b)では、画像15は、ホログラム形成領域11の形成箇所を指し示す矢印であり、ホログラム形成領域11内に光像13として「ホンモノ」を表わす文字列を再生可能なものである。図20(c)

) および (d) では、画像 15 は、楕円の一部であり、光像 13 および回折格子図柄 12 により示される楕円の他の部分と組み合わせて 1 つの楕円を表示可能なものである。図 20 (e) および (f) では、画像 15 は、文字列「ホンモノ」の一部であり、光像 13 により示される文字列「ホンモノ」の他の部分と組み合わせて 1 つの意味のある文字列「ホンモノ」を表示可能なものである。

[0160] 上記画像表示層は、所望の画像を表示できるものであればよく、例えば、着色材および樹脂材料を有する印刷層、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された回折格子図柄を有する第 2 ホログラム層等を挙げることができる。

上記印刷層は、様々な色およびパターンの画像を容易に描画できる。上記第 2 ホログラム層は、参照光を照射した場合にのみ画像を表示できる。このため、上記印刷層等は、偽造防止性および意匠性に優れたホログラム構造体を容易に形成できるからである。

上記画像表示層は、1 種類のみであっても良く、2 種類以上を組み合わせて用いるものであっても良い。例えば、画像表示層は、複数の印刷層を含むもの、印刷層および第 2 ホログラム層を含むもの等とすることができる。

以下、印刷層および第 2 ホログラム層について説明する。

[0161] (a) 印刷層

上記印刷層は、着色材および樹脂材料を有するものである。

[0162] 上記印刷層の形成位置としては、ホログラム形成領域内での光像および回折格子図柄の再生および視認を妨げない位置であれば特に限定されるものではなく、ホログラム層の蒸着層とは反対側の表面上、ホログラム層と同一平面上、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面上等とすることができる。

図 21 は、上記印刷層 5 が、透明基材 4 のホログラム層 1 とは反対側の表面上に形成される例を示すものである。

[0163] なお、印刷層についてのその他の事項については、上記「A. 第 1 実施態様」の「3. その他の構成」の「(2) 画像表示層」の「(a) 印刷層」の

項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0164] (b) 第2ホログラム層

上記第2ホログラム層は、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された回折格子図柄を有し、参照光を照射することにより、回折格子セルが配置されたパターン形状の図柄が再生されるものである。

このような回折格子図柄、回折格子セルおよび参照光については上記「1. ホログラム層」に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

図22は、上記第2ホログラム層6が、ホログラム層1の蒸着層2側の表面上に配置される例を示すものである。

[0165] なお、第2ホログラム層についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「3. その他の構成」の「(2) 画像表示層」の「(b) 第2ホログラム層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0166] (3) 層間接着層

本態様のホログラム構造体は、各構成間を接着する層間接着層を有するものであっても良い。

[0167] なお、層間接着層についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「3. その他の構成」の「(3) 層間接着層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0168] (4) 接着層

本態様のホログラム構造体は、蒸着層のホログラム層とは反対側の表面に形成された接着層を有していてもよい。接着層を有することにより、上記ホログラム構造体は被着体に容易に貼付可能となるからである。

[0169] なお、接着層についてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「3. その他の構成」の「(4) 接着層」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0170] (5) 剥離シート

また、本態様のホログラム構造体は、上述した接着層上に剥離シートが配置されていてもよい。本態様のホログラム構造体を接着層を介して所望の被着体に貼り合わせる直前に、剥離シートと接着層とを剥離して使用することが可能となる。これにより、接着層と被着体との間に異物が付着することを防止できる。

[0171] なお、剥離シートについてのその他の事項については、上記「A. 第1実施態様」の「3. その他の構成」の「(5) 剥離シート」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0172] (6) 任意の部材

さらに、本態様のホログラム構造体は、上記透明基材上や上記ホログラム層の非ホログラム形成領域上に紫外線吸収層や赤外線吸収層、反射防止層等を有していてもよい。この様な層を有することにより、上記ホログラム構造体に紫外線吸収機能や赤外線吸収機能、反射防止機能等を付与することができ、本態様のホログラム構造体を各種フィルタ等としても用いることが可能となる。

なお、これらの層については、一般的に用いられるものと同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。

[0173] 4. ホログラム構造体

本態様のホログラム構造体は、ホログラム構造体を被着体に接着して使用するものであっても良く、被着体に接着せずに使用するものであっても良い。

[0174] 上記被着体に接着して使用する態様としては、被着体との接着に用いられる接着層を有するものであれば特に限定されるものではなく、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された接着層を有し、ホログラムシールとして用いられる態様（第1使用態様）、上記蒸着層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成されたヒートシール層と、上記ホログラム層の上記蒸着層とは反対側の表面に形成された剥離容易層と、上記剥離容易層の上記ホログラム層とは反対側の表面に形成された剥離用基材と、を有し、ホ

ログラム転写箔として用いられる態様（第2使用態様）等を挙げることができる。

また、上記被着体に接着せずに使用する態様としては、情報記録媒体として用いられる態様（第3使用態様）等を挙げることができる。

[0175] なお、本態様のホログラム構造体の各使用態様については、上記「A. 第1実施態様」の「4. ホログラム構造体」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0176] 5. 製造方法

本態様のホログラム構造体の製造方法は、上記「A. 第1実施態様」の「5. 製造方法」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0177] 6. 用途

本態様のホログラム構造体の用途としては、上記「A. 第1実施態様」の「6. 用途」の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。

[0178] 本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

実施例

[0179] 以下に実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

[0180] [実施例1-1]

<原版およびホログラム構造体の形成>

合成石英の基板の上に表面低反射クロム薄膜が積層されたフォトマスクブランク板のクロム薄膜上に、ドライエッチング用レジストをスピナーにより回転塗布した。ドライエッチング用レジストとしては日本ゼオン（株）製ZEP7000を使用し、400nmの厚みとなるように形成した。このレジスト層に対し、電子線描画装置(MEBES4500：ETEC社製)を用い、事前に計算機

で作成したパターンを露光し、レジスト樹脂の露光部分を易溶化した。その後、現像液を噴霧し（スプレー現像）して易溶化部分を除去し、レジストパターンを形成した。

なお、パターンの格子ピッチは、3179 nmとした。

続いて、形成されたレジストパターンを利用して、ドライエッチングによりレジストで被覆されていない部分のクロム薄膜をエッチング除去し、石英基板を露出させた。次いで、露出した石英基板をエッチングし、石英基板に凹部を形成した。その後、レジスト薄膜を溶解除去することにより、石英基板がエッチングされて生じた凹部と、石英基板およびクロム薄膜がエッチングされずに残存している凸部とを有する原版を得た。また、原版のサイズ、すなわち、ホログラムセルのサイズを0.25 mmとした。

厚み0.5 mmのポリカーボネートシート（透明基材）に、ホログラム層形成用組成物（UV硬化性アクリレート樹脂：屈折率1.52 測定波長633 nm）を滴下し、上記組成物の塗膜を形成した。次いで、上記塗膜上に凹凸を有する原版を積置し、押圧した。次に、活性放射線を照射して上記塗膜を硬化させた後剥離させ、原版の凹凸型を反転させた凹凸表面を有するホログラムセルを形成した。その後、原版の積置、押圧、硬化および剥離を繰り返す、ホログラムセルが敷き詰められた15 mm角のホログラム形成領域を有する厚さ2 μmのホログラム層を形成した。

[0181] 次いで、ホログラム層の凹凸表面側の全面に膜厚100 nmのA1層をスパッタリング法により形成し、ホログラム構造体を得た。

[0182] <評価>

ホログラム構造体のホログラム層表面から50 mmの位置に点光源を配置し、ホログラム層表面から300 mm離れた箇所から観察したところ、15 mm角のホログラム形成領域内にフーリエ変換された所定の画像を視認性良く観察することができた。

[0183] [実施例2-1]

<回折格子セル用原版および回折格子図柄の形成>

合成石英の基板の上に表面低反射クロム薄膜が積層されたフォトマスクブランク板のクロム薄膜上に、ドライエッチング用レジストをスピナーにより回転塗布した。ドライエッチング用レジストとしては日本ゼオン（株）製ZEP7000を使用し、400nmの厚みとなるように形成した。このレジスト層に対し、電子線描画装置(MEBES4500：ETEC社製)を用い、事前に計算機で作成したパターンを露光し、レジスト樹脂の露光部分を易溶化した。その後、現像液を噴霧し（スプレー現像）して易溶化部分を除去し、レジストパターンを形成した。

なお、パターンの格子ピッチは、500nmとした。

続いて、形成されたレジストパターンを利用して、ドライエッチングによりレジストで被覆されていない部分のクロム薄膜をエッチング除去し、石英基板を露出させた。次いで、露出した石英基板をエッチングし、石英基板に凹部を形成した。その後、レジスト薄膜を溶解除去することにより、石英基板がエッチングされて生じた凹部と、石英基板およびクロム薄膜がエッチングされずに残存している凸部とを有する原版を得た。また、原版のサイズ、すなわち、回折格子セルのサイズは0.25mmとした。

厚み0.5mmのポリカーボネートシート（透明基材）に、ホログラム層形成用組成物（UV硬化性アクリレート樹脂：屈折率1.52 測定波長633nm）を滴下し、上記組成物の塗膜を形成した。次いで、上記塗膜上に凹凸を有する原版を積置し、押圧した。次に、活性放射線を照射して上記塗膜を硬化させた後剥離させ、原版の凹凸型を反転させた凹凸表面を有する回折格子セルを形成した。その後、原版の積置、押圧、硬化および剥離を繰り返し、回折格子セルにより平面回折格子図柄を15mm角のホログラム形成領域内に形成した。

[0184] <ホログラムセル用原版およびホログラムセルの形成>

回折格子セル用原版と同様の方法により原版を得た。

原版のサイズ、すなわち、ホログラムセルのサイズを0.25mmとした

。

また、パターンの格子ピッチは、3179 nmとした。

次いで、回折格子図柄形成後の上記塗膜上に上記原版の積置、押圧、硬化および剥離を繰り返し、回折格子セルが配置されていない領域にホログラムセルが敷き詰められた15 mm角のホログラム形成領域を有する厚さ2 μmのホログラム層を形成した。

[0185] 次いで、ホログラム層の凹凸表面側の全面に膜厚100 nmのA1層をスパッタリング法により形成し、ホログラム構造体を得た。

[0186] <評価>

ホログラム構造体を蛍光灯下で観察したところ、ホログラム形成領域内に回折格子図柄を再生することができた。また、ホログラム構造体のホログラム層表面から50 mmの位置に点光源を配置し、ホログラム層表面から300 mm離れた箇所から観察したところ、15 mm角のホログラム形成領域内にフーリエ変換された所定の画像と回折格子図柄との両者を視認性良く観察することができた。

符号の説明

- [0187] 1 … ホログラム層
1 a … 凹凸表面
2 … 蒸着層
3 … 層間接着層
4 … 透明基材
5 … 印刷層
6 … 第2ホログラム層
7 … 第2蒸着層
10 … ホログラム構造体
11 … ホログラム形成領域
11 a、13 a … ホログラムセル
12 … 回折格子図柄
12 a、16 a … 回折格子セル

- 1 3 … 光像
- 1 5 … 画像
- 3 1 … 接着層
- 3 2 … 剥離シート
- 3 3 … ヒートシール層
- 3 4 … 剥離容易層
- 3 5 … 剥離用基材
- 3 6 … 裏面側保護層
- 3 7 … 表面側保護層

請求の範囲

- [請求項1] 点光源から入射した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記録された反射型ホログラム形成領域を有するホログラム層と、
- 前記ホログラム層の前記反射型ホログラム形成領域の凹凸表面に接するように形成された蒸着層と、
- を有し、
- 前記反射型ホログラム形成領域の平面視サイズが、5 mm角以上50 mm角以下の範囲内であることを特徴とするホログラム構造体。
- [請求項2] 前記反射型ホログラム形成領域は、点光源から入射した光を前記光像へ変換可能なホログラムセルが複数配列されたものであり、
- 前記ホログラムセルの平面視サイズが、0.25 mm角以上5 mm角以下の範囲内であることを特徴とする請求項1に記載のホログラム構造体。
- [請求項3] 前記凹凸表面の格子ピッチが、1.0 μm ~ 80.0 μm の範囲内であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のホログラム構造体。
- [請求項4] 前記ホログラム構造体が、前記光像と組み合わせて用いられる画像を表示する画像表示層を有することを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれかの請求項に記載のホログラム構造体。
- [請求項5] 前記画像表示層が着色材および樹脂材料を有する印刷層を含むことを特徴とする請求項4に記載のホログラム構造体。
- [請求項6] 前記画像表示層が、平面視上パターン状に配置された回折格子セルにより描画された回折格子図柄を有する第2ホログラム層を含むことを特徴とする請求項4または請求項5に記載のホログラム構造体。
- [請求項7] 前記回折格子図柄が、平面的に図柄を再生可能な平面回折格子図柄であることを特徴とする請求項6に記載のホログラム構造体。
- [請求項8] 前記回折格子図柄が、立体的に図柄を再生可能な立体回折格子図柄

であることを特徴とする請求項6に記載のホログラム構造体。

[請求項9]

ホログラム形成領域を有するホログラム層と、
前記ホログラム層の前記ホログラム形成領域の凹凸表面に接するよう
に形成された蒸着層と、
を有し、

前記ホログラム層の前記ホログラム形成領域には、点光源から入射
した光を所望の光像へ変換する、位相型フーリエ変換ホログラムが記
録されたホログラムセルと、前記ホログラムセルと同一平面上に形成
され、平面視上パターン状に配置されることにより回折格子図柄を再
生する回折格子セルと、が配置されていることを特徴とするホログラ
ム構造体。

[請求項10]

前記回折格子図柄が、平面的に図柄を再生可能な平面回折格子図柄
であることを特徴とする請求項9に記載のホログラム構造体。

[請求項11]

前記ホログラム形成領域内の前記ホログラムセルの合計面積に対す
る前記回折格子セルの合計面積の割合（回折格子セルの合計面積／ホ
ログラムセルの合計面積）が、 $1/4 \sim 3/2$ の範囲内であることを
特徴とする請求項10に記載のホログラム構造体。

[請求項12]

前記回折格子図柄が、立体的に図柄を再生可能な立体回折格子図柄
であることを特徴とする請求項9に記載のホログラム構造体。

[請求項13]

前記ホログラム形成領域内の前記ホログラムセルの合計面積に対す
る前記回折格子セルの合計面積の割合（回折格子セルの合計面積／ホ
ログラムセルの合計面積）が、 $1/3 \sim 3$ の範囲内であることを特徴
とする請求項12に記載のホログラム構造体。

[請求項14]

前記蒸着層の前記ホログラム層とは反対側の表面に形成された接着
層を有し、

ホログラムシールとして用いられることを特徴とする請求項1から
請求項13までのいずれかの請求項に記載のホログラム構造体。

[請求項15]

前記蒸着層の前記ホログラム層とは反対側の表面に形成されたヒー

トシール層と、

前記ホログラム層の前記蒸着層とは反対側の表面に形成された剥離容易層と、

前記剥離容易層の前記ホログラム層とは反対側の表面に形成された剥離用基材と、

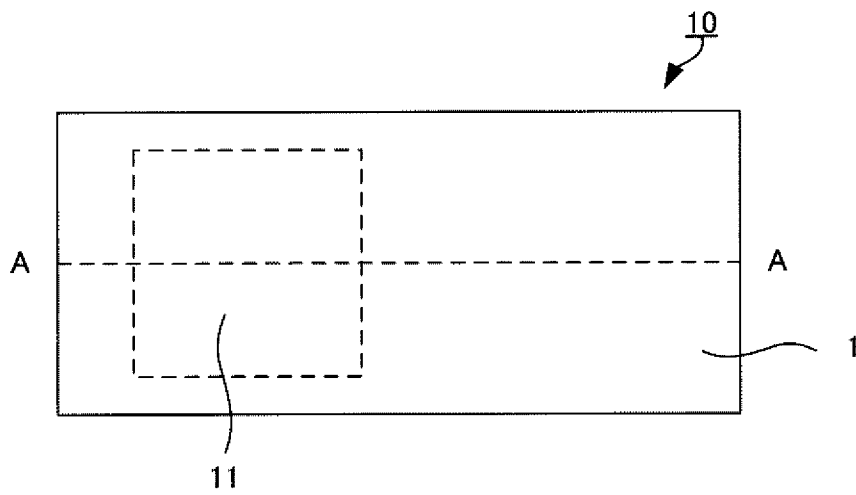
を有し、

ホログラム転写箔として用いられることを特徴とする請求項 1 から請求項 1 3 までのいずれかの請求項に記載のホログラム構造体。

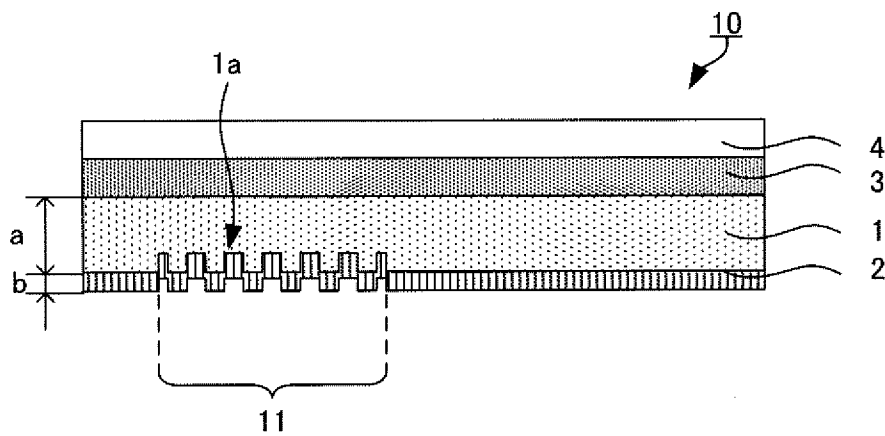
[請求項16]

情報記録媒体として用いられることを特徴とする請求項 1 から請求項 1 3 までのいずれかの請求項に記載のホログラム構造体。

[図1]

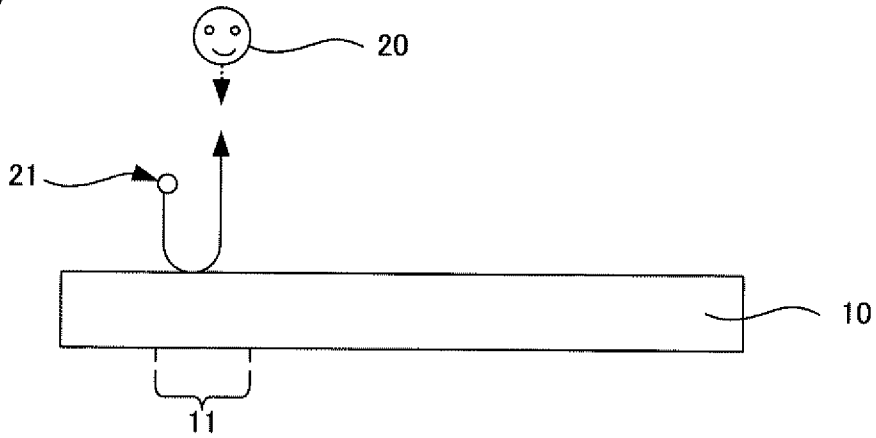


[図2]

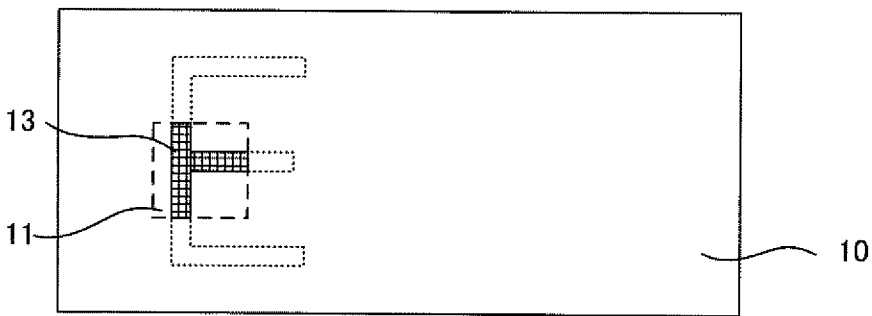


[図3]

(a)

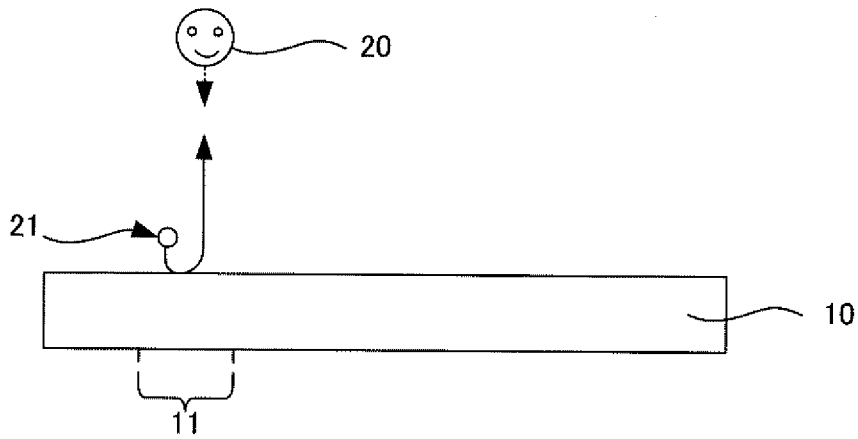


(b)

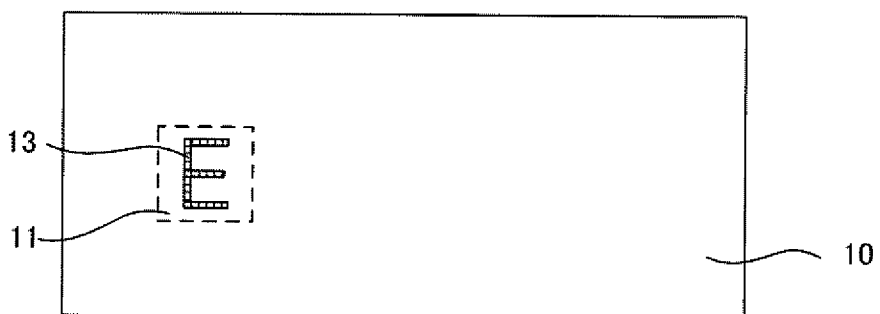


[図4]

(a)

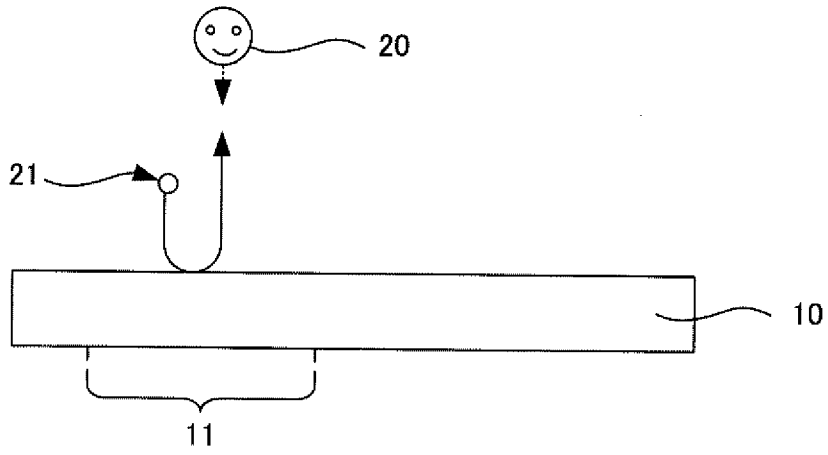


(b)

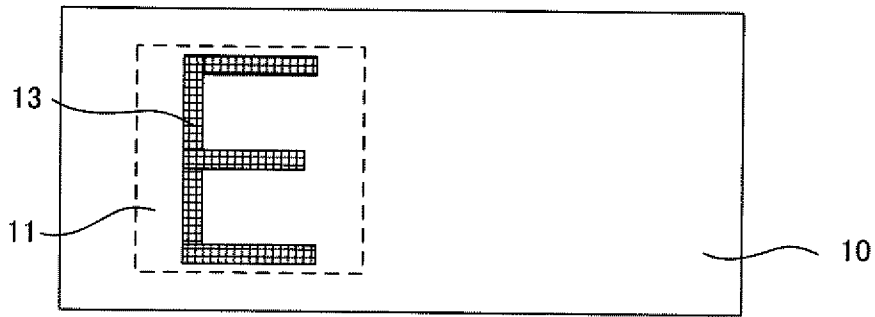


[図5]

(a)

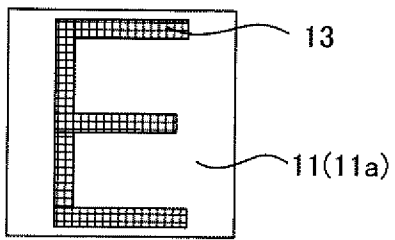


(b)

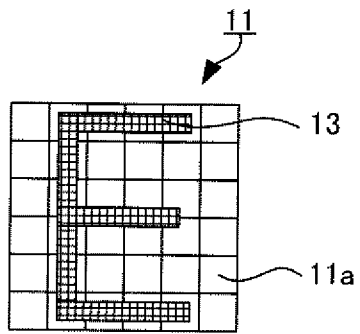


[図6]

(a)

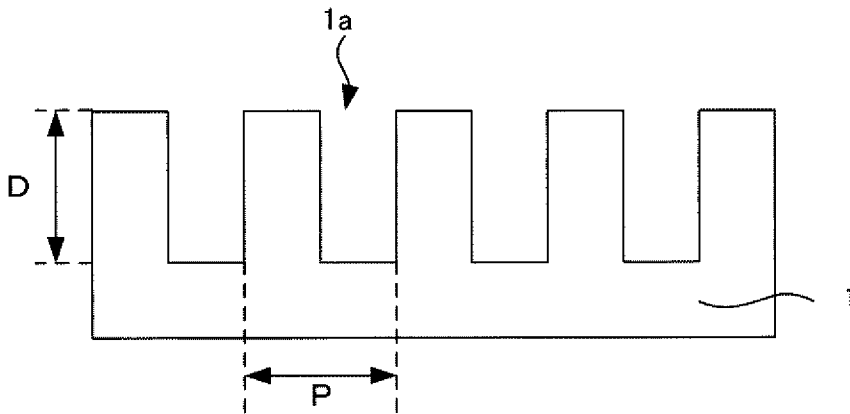


(b)

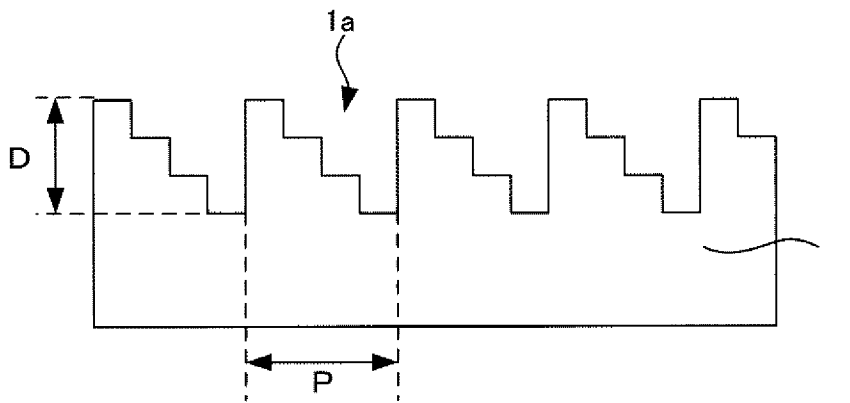


[図7]

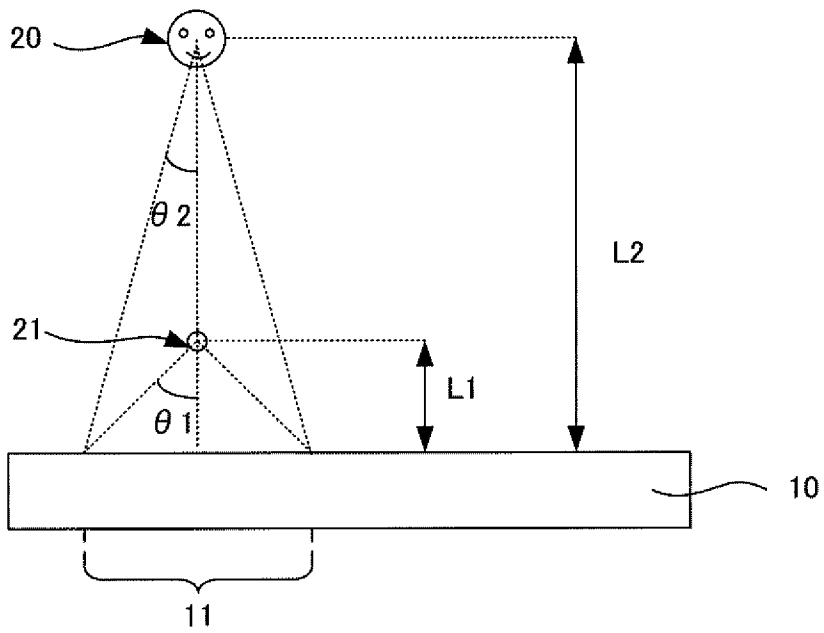
(a)



(b)

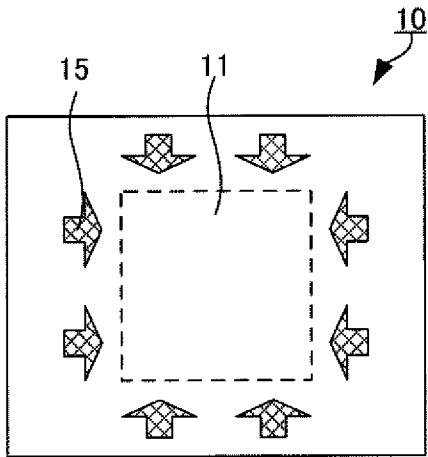


[図8]

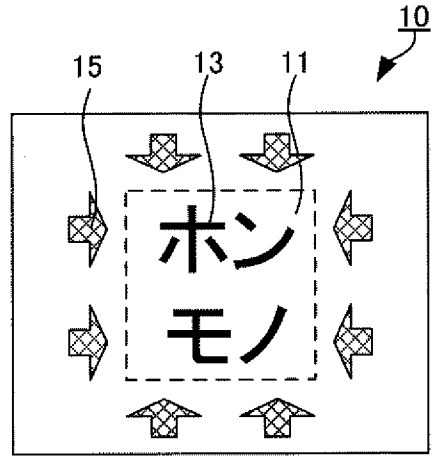


[図9]

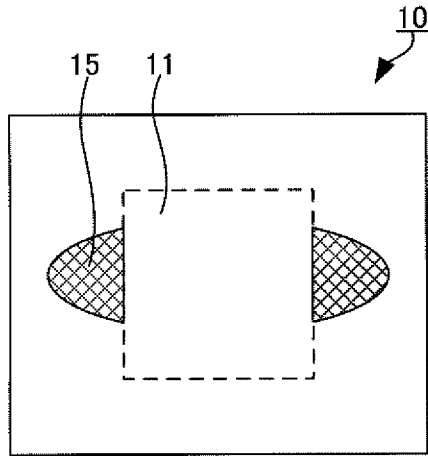
(a)



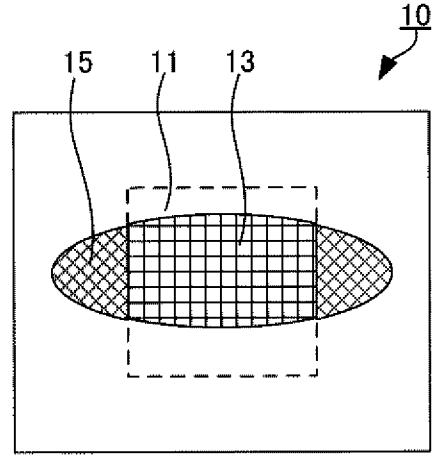
(b)



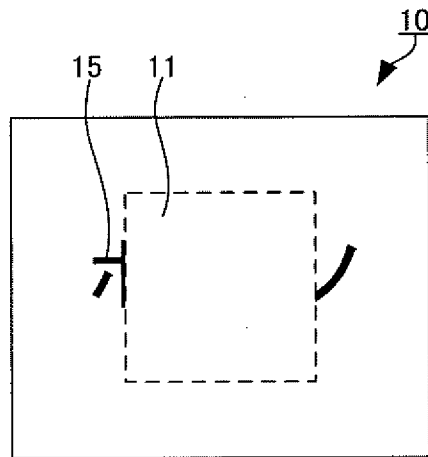
(c)



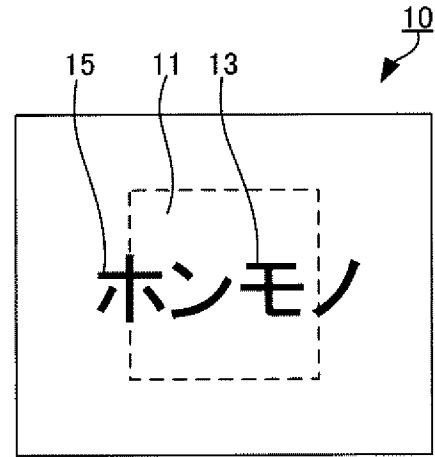
(d)



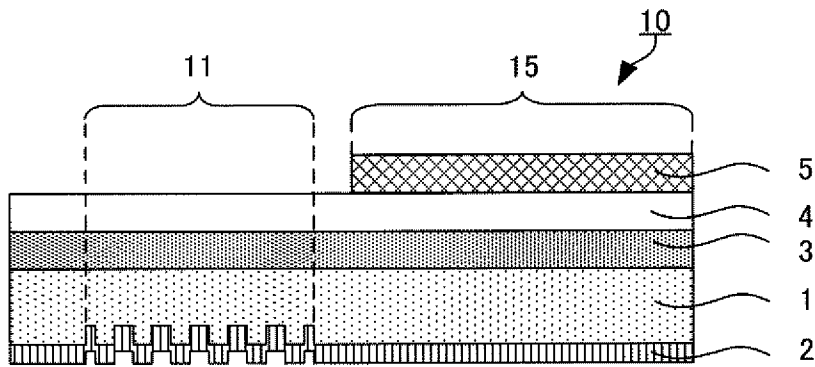
(e)



(f)

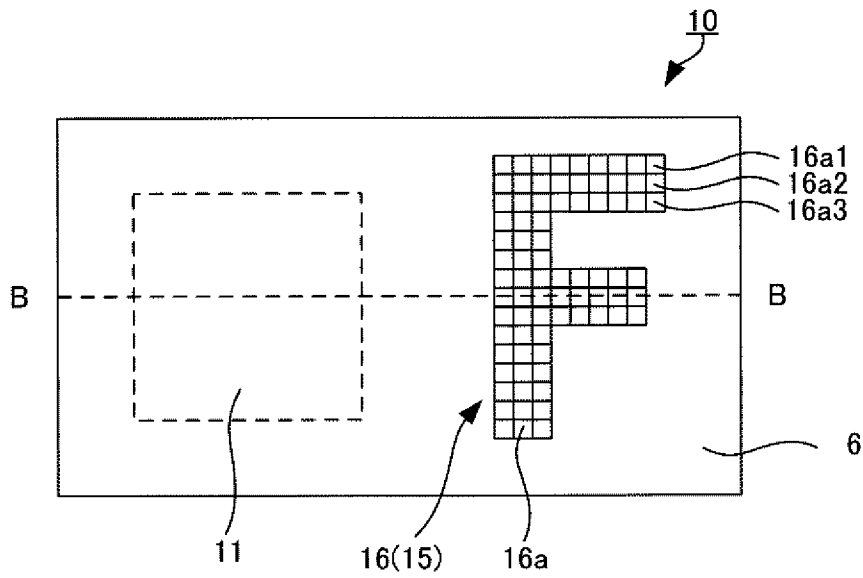


[図10]

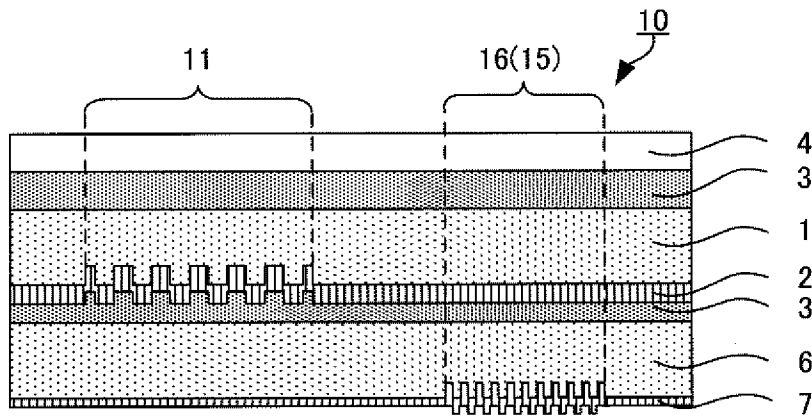


[図11]

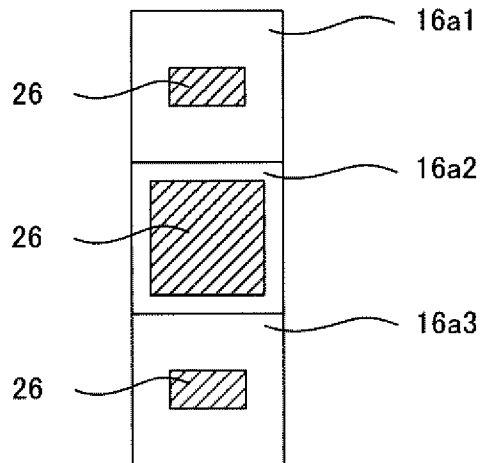
(a)



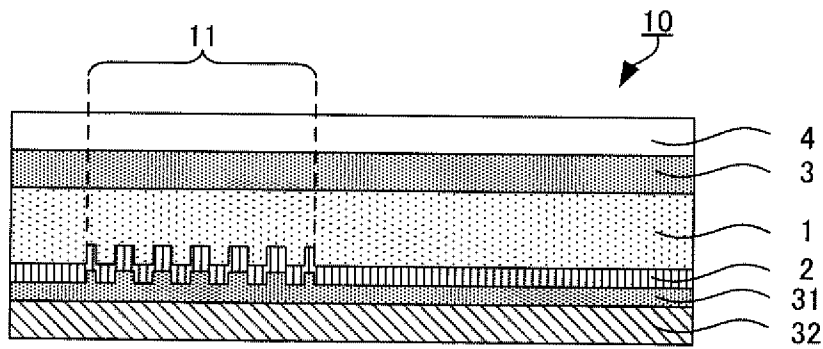
(b)



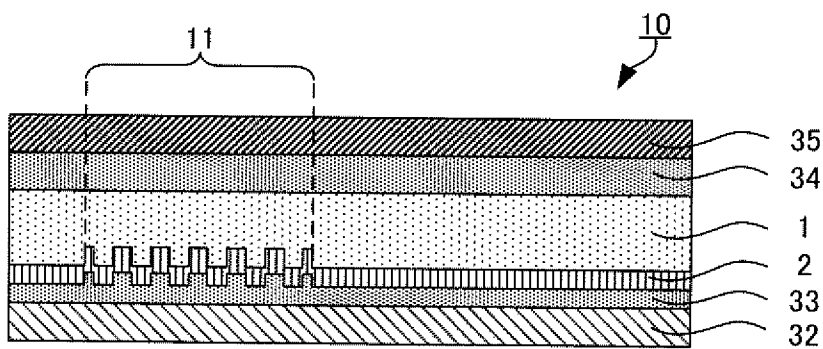
[図12]



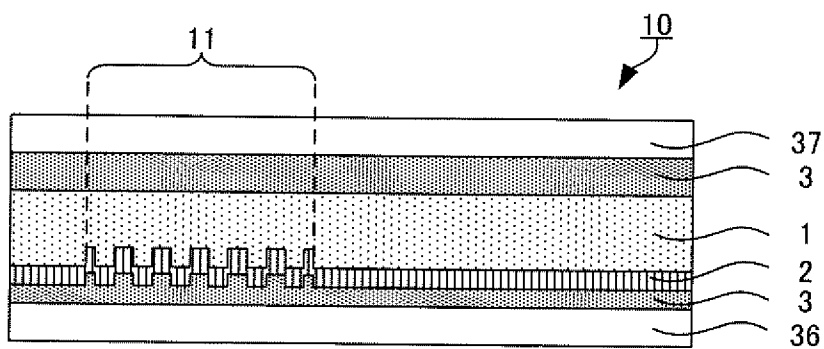
[図13]



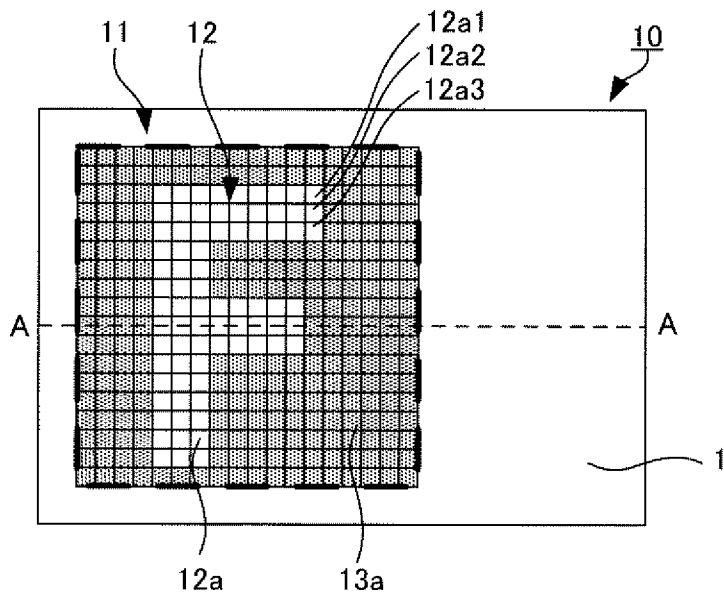
[図14]



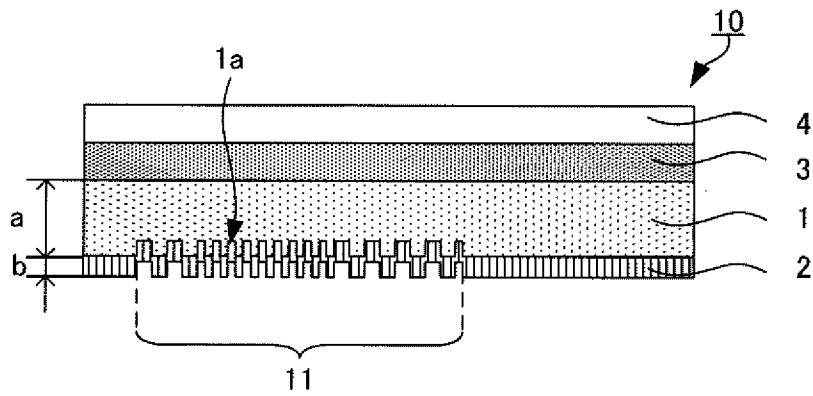
[図15]



[図16]

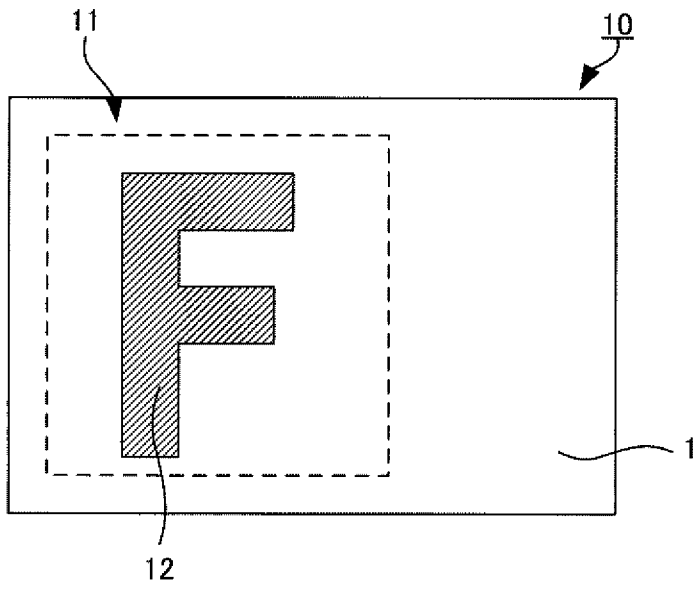


[図17]

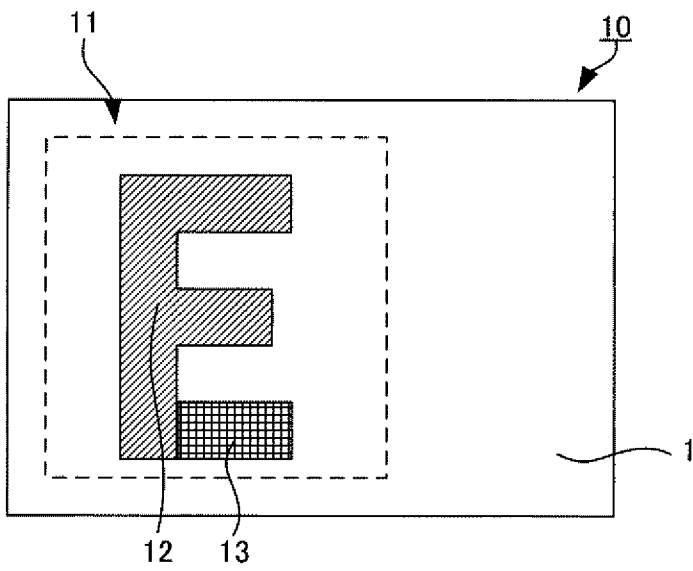


[図18]

(a)

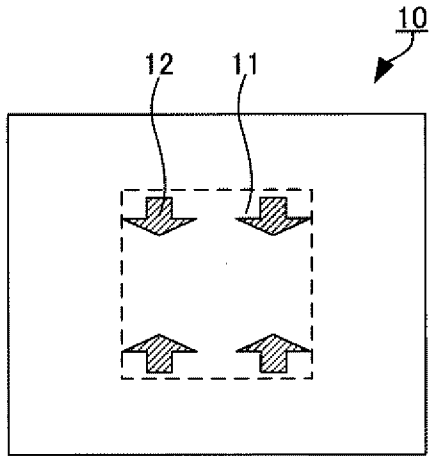


(b)

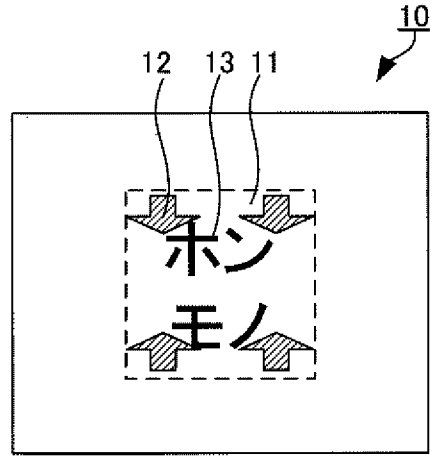


[図19]

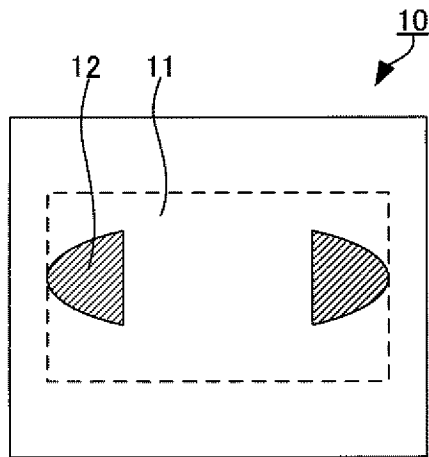
(a)



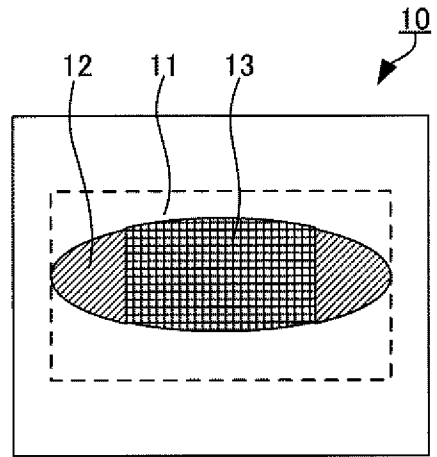
(b)



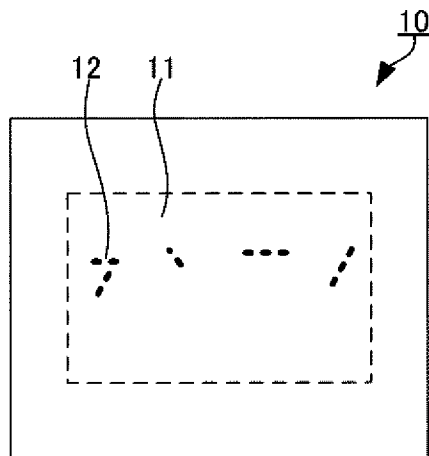
(c)



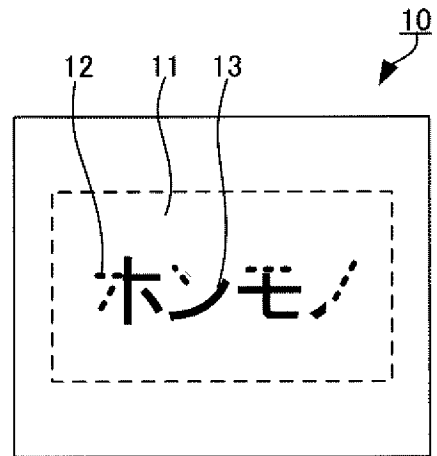
(d)



(e)

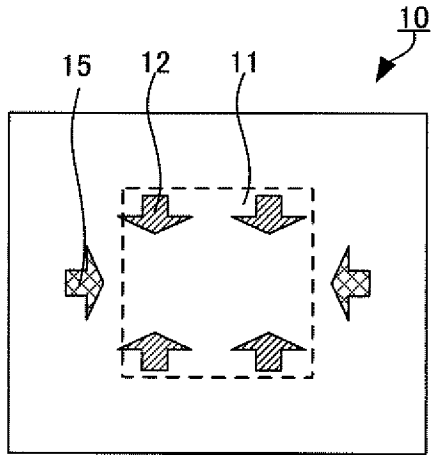


(f)

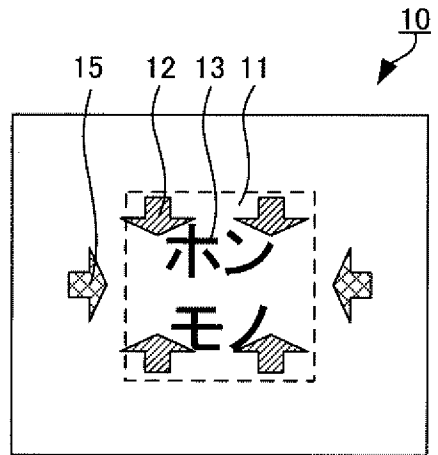


[図20]

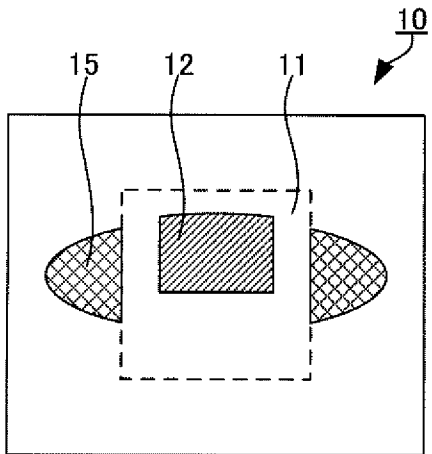
(a)



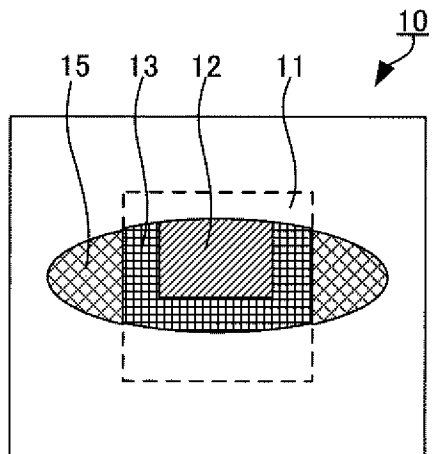
(b)



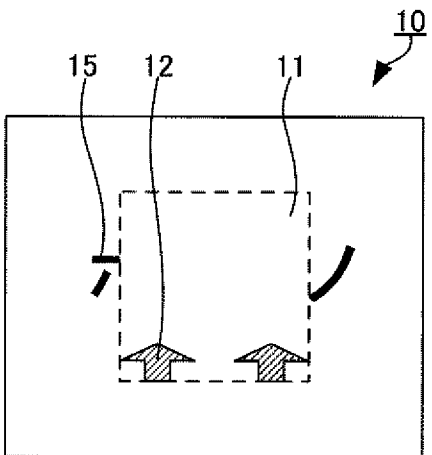
(c)



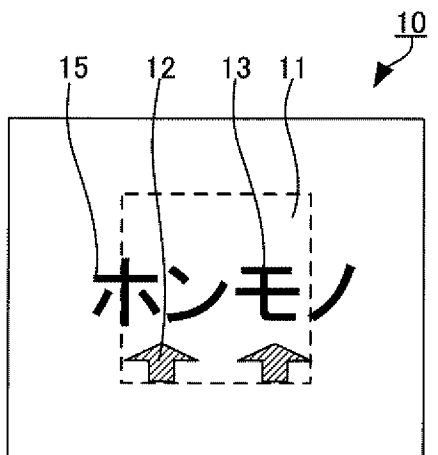
(d)



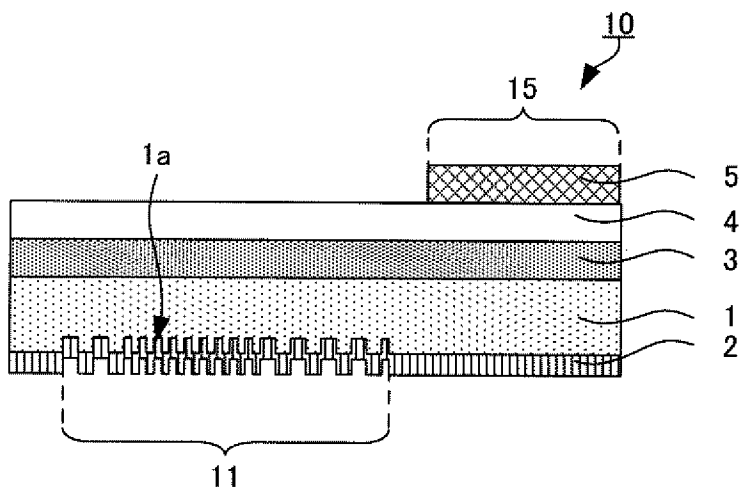
(e)



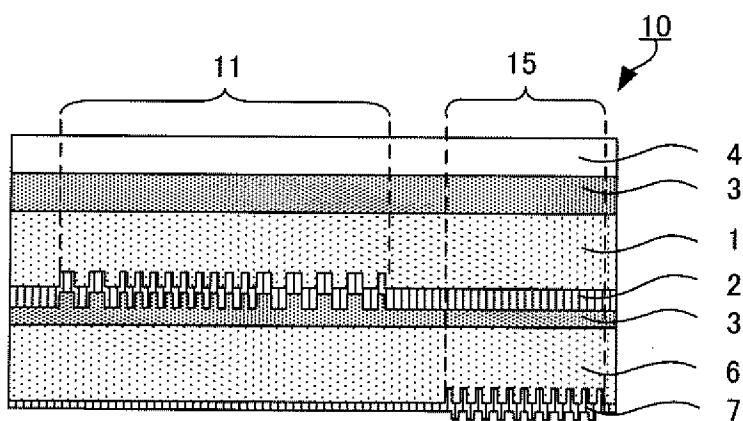
(f)



[図21]



[図22]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/073626

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G03H1/02(2006.01)i, B42D25/328(2014.01)i, G02B5/18(2006.01)i, G09F3/02(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G03H1/02, B42D25/328, G02B5/18, G09F3/02 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2016 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2016 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2016 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2002-215009 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 31 July 2002 (31.07.2002), claims; paragraphs [0001], [0004], [0038], [0044] to [0057]; fig. 1 to 3 (Family: none)	1, 3-5, 16 2, 6-15
Y	JP 5-201182 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 10 August 1993 (10.08.1993), paragraph [0037] (Family: none)	2, 9-13
Y	JP 2011-760 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 06 January 2011 (06.01.2011), paragraph [0056] (Family: none)	6-13
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 01 November 2016 (01.11.16)		Date of mailing of the international search report 15 November 2016 (15.11.16)
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/073626

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2012-173535 A (Toppan Printing Co., Ltd.), 10 September 2012 (10.09.2012), paragraph [0002] (Family: none)	14-15
Y	JP 5-48210 Y2 (Dainippon Printing Co., Ltd.), 21 December 1993 (21.12.1993), claims; specification, column 2, line 14 to column 4, line 5 (Family: none)	14-15
Y	JP 2002-140682 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 17 May 2002 (17.05.2002), paragraphs [0014] to [0026]; fig. 3 (Family: none)	14-15

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. G03H1/02(2006.01)i, B42D25/328(2014.01)i, G02B5/18(2006.01)i, G09F3/02(2006.01)i										
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. G03H1/02, B42D25/328, G02B5/18, G09F3/02										
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2016年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2016年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2016年</td> </tr> </table>			日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2016年	日本国実用新案登録公報	1996-2016年	日本国登録実用新案公報	1994-2016年
日本国実用新案公報	1922-1996年									
日本国公開実用新案公報	1971-2016年									
日本国実用新案登録公報	1996-2016年									
日本国登録実用新案公報	1994-2016年									
国際調査で利用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）										
C. 関連すると認められる文献										
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号								
X Y	JP 2002-215009 A（大日本印刷株式会社）2002.07.31, 特許請求の 範囲, [0001], [0004], [0038], [0044]-[0057], 図 1-3（ファミリーな し）	1, 3-5, 16 2, 6-15								
Y	JP 5-201182 A（大日本印刷株式会社）1993.08.10, [0037]（ファミ リーなし）	2, 9-13								
Y	JP 2011-760 A（大日本印刷株式会社）2011.01.06, [0056]（ファミ リーなし）	6-13								
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。										
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献										
国際調査を完了した日 01.11.2016	国際調査報告の発送日 15.11.2016									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 堀井 康司 電話番号 03-3581-1101 内線 3271	20 3713								

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2012-173535 A (凸版印刷株式会社) 2012.09.10, [0002] (ファミリーなし)	14-15
Y	JP 5-48210 Y2 (大日本印刷株式会社) 1993.12.21, 実用新案登録請求の範囲, 明細書第2欄14行-第4欄第5行 (ファミリーなし)	14-15
Y	JP 2002-140682 A (大日本印刷株式会社) 2002.05.17, [0014]-[0026], 図3 (ファミリーなし)	14-15